

WPINDEX	Derwent World Patent Index® Standard File
WPIDS	Derwent World Patent Index® Subscriber File
WPIX	Derwent World Patent Index® Subscriber File with Extension Abstract * WPIDS/WPIX ファイルは会員用ファイルです。非会員の方は WPINDEX ファイルをご利用ください
収録範囲	特許取得可能なすべての科学技術分野。主題分野別の収録開始年は以下の通り。 ・医薬：1963年 ・農薬：1965年 ・プラスチック、ポリマー：1966年 ・その他の化学一般分野：1970年 ・機械、電気、一般技術：1974年
ファイル種類	書誌データベース
特徴	各種シソーラス：国際特許分類 (/IPC), 共通特許分類 (/CPC), ヨーロッパ特許分類 (/EPC, /ICO), 米国特許分類 (/NCL), FI (/FCL), F ターム (/FTERM), マニュアルコード (/MC), 新ポリマー索引 (/PLE)*, タイトルターム (/TT). 以下のフィールドは、オンラインシソーラスと同様の機能が利用可能です。ダウエント化合物番号 (/DCN)*, ダウエント登録番号 (/DRN)*, 特許出願人コード (/PACO), プラスドックキーシリアル番号 (/KS) * (*は WPIDS/WPIX のみ) アラート (自動 SDI 検索) 毎月, 毎週, 更新ごと (週に 1-2 回, デフォルト) CAS 登録番号 <input type="checkbox"/> ページイメージ <input type="checkbox"/> STN AnaVist <input checked="" type="checkbox"/> Keep & Share <input checked="" type="checkbox"/> 中間一致・後方一致検索 <input checked="" type="checkbox"/> STN Easy <input checked="" type="checkbox"/> 練習用ファイル <input checked="" type="checkbox"/> 構造図 <input type="checkbox"/>
レコード内容	<文献レコード> ・各レコードで利用可能な対応特許情報 - ベーシック特許 - 対応特許 (他国で発行された同一発明に関する特許) ・発明レベル：書誌情報, Clarivate Analytics が作成した標題, 抄録, 一般的な索引, および化学分野と電気分野の詳細な索引, 電気分野およびエンジニアリング分野の図面, 化学構造図を収録。 ・公報レベル：特許ファミリーを構成する個々の公報の書誌情報と著者標題・抄録, メインクレーム, 住所を含む代理人情報, 特許出願人情報を収録。それぞれの公報レベルに限定した検索も可能。 ・発明レベルと公報レベルは, 個々にあるいはまとめて検索が可能。 ・会員のレベルによって, 使用できるファイル・機能が異なる。WPIDS ファイルでは会員用コード (/DEN, /DRN, /PLE, /KS など) が利用可能。WPIX ファイルでは, 会員用コードおよび, 詳細な発明内容を記述する拡張抄録フィールド (ABEX), ドキュメンテーション抄録 (ABDT), XML ダウンロードリンクが利用可能。 <構造レコード> ・DCR (Derwent Chemistry Resource) を収録。構造検索や物質同定情報を利用した各種の検索が可能。DCR ファイルセグメントの結果は書誌情報とリンク。

ヨーロッパ STN カールスルーエ FIZ Karlsruhe P.O. Box 2465 76012 Karlsruhe Germany Phone: +49-7247-808-555 Fax: +49-7247-808-259 E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de Internet: www.stn-international.de	日本 STN 東京 化学情報協会 〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル Phone: 0120-003-462 (Help Desk) : 0120-151-462 (上記以外) Fax: 03-5978-4090 E-mail: support@jaici.or.jp (Help Desk) customer@jaici.or.jp (上記以外) Internet: www.jaici.or.jp	北アメリカ STN コロンバス CAS P.O. Box 3012 Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A. CAS Customer Care: Phone: 800-753-4227 (North America) 614-447-3700 (worldwide) Fax: 614-447-3751 E-mail: help@cas.org Internet: www.cas.org
---	--	---

レコード数	28,900,000 件以上のレコード (2015 年 9 月現在) 20,300,000 件以上のイメージ (2015 年 9 月現在)	
収録年代	1963 年以降 電気分野およびエンジニアリング分野の図面 : 1988 年以降 化学構造図 : 1992 年以降	
更新頻度	3-4 日毎に更新 (週 1-2 回)	1 回の更新で約 16,500 件のベーシック特許, 約 23,000 件の対応特許を追加, ポリマーおよびケミカルコード, 約 14,000 件の図面/化学構造図を追加
言語	英語	
データベース 製作者	Clarivate Analytics (UK) Limited Friars House, 160 Blackfriars Rd. London SE1 8EZ United Kingdom Copyright Holder: Clarivate Analytics	
データベース 代理店	クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社 (日本法人) 〒107-6119 東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル 19F	
収録源	アルゼンチン (1975 年, 2015 年以降) オーストラリア (1963-1969 年, 1983 年以降) オーストリア (1975 年以降) ベルギー (1963 年以降) ブラジル (1976 年以降) カナダ (1963 年以降) 中国 (1986 年以降) チェコ (1994 年以降) チェコスロバキア (1975-1994 年) デンマーク (1974 年以降) EPO (1978 年以降) フィンランド (1974 年以降) フランス (1963 年以降) ドイツ (1963 年以降) ドイツの実用新案 (1996 年以降) 旧東ドイツ (1963 年-1990 年まで) 湾岸協力会議 (GC) (2004 年以降) 香港 (2011 年以降) ハンガリー (1975 年以降) インド (2004 年以降) インドネシア (2010 年以降) アイルランド (1963-1969 年, 1995 年以降) イスラエル (1975 年以降) イタリア (1977 年以降)	日本 (1963 年以降) 韓国 (1986 年以降) ルクセンブルグ (1984 年以降) メキシコ (1997 年以降) マレーシア (2010 年以降) オランダ (1963 年以降) ニュージーランド (1993 年以降) ノルウェー (1974 年以降) PCT-WIPO (1978 年以降) フィリピン (1992 年以降) ポーランド (2011 年以降) ポルトガル (1974 年以降) ルーマニア (1975 年以降) ロシア (1993 年以降) シンガポール (1995 年以降) スロバキア (1993 年以降) 南アフリカ (1963 年以降) 旧ソ連 (1963 年-1994 年) スペイン (1983 年以降) スウェーデン (1974 年以降) スイス (1963 年以降) タイ (2010 年以降) 台湾 (1993 年以降) トルコ (2015 年以降) イギリス (1963 年以降) アメリカ (1963 年以降) ベトナム (2010 年以降)
	<ul style="list-style-type: none"> ・その他の収録源 <ul style="list-style-type: none"> - Research Disclosure 誌 (1978 年以降) 著作権 : Kenneth Mason Publications Limited [2006] www.researchdisclosure.com - International Technology Disclosures 誌 (1984-1993 年) 	
	* 詳細については、以下の URL から資料をダウンロードすることができます。 http://ip-science.thomsonreuters.com/support/patents/coverage	

収録源 (続き)	公報レベルには以下の国の特許情報（明細書の標題，抄録，メインクレーム，発明者，特許出願人，代理人，住所など）を収録しています。	
	オーストラリア（2004 年以降） ドイツ（1968 年以降） 日本（1975 年以降） アメリカ（1975 年以降） 韓国（2008 年以降） ロシア（2009 年以降） スペイン（2010 年以降） インド（2009 年以降）	EPO（1978 年以降） PCT (WIPO)（1978 年以降） イギリス（1984-1997, 2004 年以降） 中国（2007 年 6 月以降） 台湾（2008 年以降） フランス（2009 年以降） ブラジル（2010 年以降）
検索補助 資料	<ul style="list-style-type: none"> • 講習会テキスト https://www.jaici.or.jp/seminar/text.php • STN 技術資料 http://www.jaici.or.jp/stn/stn_doc_01.html • オンラインヘルプ => <u>HELP DIRECTORY</u> ですべての利用可能なヘルプメッセージが表示されます • STNGUIDE ファイル STN の各ファイルの最新版サマリーシートの全情報と料金表をオンラインで参照できます • Derwent World Patent Index STN online User guide (http://www.stn-international.com/stn_guide.html) • 以下の資料は，Clarivate Analytics より入手可能です。 <ul style="list-style-type: none"> - Patent Sources - Introduction to Chemical Indexing - Classification User Guide - Title Terms User Guide - Patentee Codes User Guide - CPI Chemical Indexing Guidelines, Indexing of Chemical and Pharmaceutical Patents - CPI Chemical Indexing User Guide - CPI Manual Codes User Guide - Chemistry Resource on STN - CPI Plasdoc Coding Systems User Guide - Polymer Indexing Directory Parts 1 and 2 - Polymer Indexing Reference Manual - Polymer Indexing System Description User Guide - Polymer Indexing Thesaurus Guide - Polymer Indexing Hierarchy User Guide - EPI Manual Codes User Guide Parts 1, 2 and 3 	
利用可能な クラスター	<ul style="list-style-type: none"> • AEROTECH • ALLBIB • 2ANAVIST (2HANAVIST) • AUTHORS • BIOSCIENCE 	<ul style="list-style-type: none"> • CORPSOURCE • ENGINEERING • FORMULATIONS • PATENTS (HPATENTS) • POLYMERS

サマリーシートを初めてご覧になる方は，「サマリーシートの見方」をご参照ください。

<http://www.jaici.or.jp/stn/dbsummary/db.html>

検索フィールド

中間一致および後方一致可能なフィールドはアスタリスク (*) で示してあります。

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
なし または /BI, /BIX	基本索引 * 標題 (/TI) タイトルターム (/TT) 追加語 (AW) 拡張抄録 (/ABEX) ドキュメンテーション抄録 (/ABDT) 抄録 (/AB) ¹⁾ 第一セクション (/ALE) Novelty (/NOV) Detailed Description (/DETD) Mechanism of Action (/ACTN) Activity (/ACTV) Advantage (/ADV) Use/Advantage (/UADV) Use (/USE) Drawing Description (/DRWD) 対応特許抄録 (ABEQ) Technology Focus (/TECH) (以上からの切出し語)	S DRILLING FLUID AND EMULS? S ?PHENYLETHER? S #####DIPHENYLETHER S ULCER TREATMENT(L) ORAL	AB, NOV, DETD, ACTN, ACTV, AW, ADV, ALE, UADV, USE, DRWD, ABDT ²⁾ , ABEQ, ABEX ²⁾ , TECH, TI, TT
/AB /ABDT /ABDT.ACTN /ABDT.ACTV /ABDT.ADM /ABDT.ADV /ABDT.BIO /ABDT.CLM /ABDT.DEF /ABDT.DES /ABDT.DOS /ABDT.DRWD /ABDT.EMB	抄録 ¹⁾ * ドキュメンテーション抄録 ドキュメンテーション抄録, Mechanism of Action ドキュメンテーション抄録, Activity ドキュメンテーション抄録, Administration ドキュメンテーション抄録, Advantage ドキュメンテーション抄録, Biology ドキュメンテーション抄録, Claimed ドキュメンテーション抄録, Definition ドキュメンテーション抄録, Description ドキュメンテーション抄録, Dosage ドキュメンテーション抄録, Drawing Description ドキュメンテーション抄録, Embodiment	S OSTEOGENIC PROTEIN/AB S (DNA AND PROTEIN)/ABDT S CELL?/ABDT.ACTN S AGONIST?/ABDT.ACTV S ORAL/ABDT.ADM S (STRENGTH AND (INCREAS? OR RIS? OR GAIN?))/ABDT.ADV S (LEUKAEM? AND CELL?)/ABDT.BIO S KETON?/ABDT.CLM S CYCL?/ABDT.DEF S ARYL?/ABDT.DES S (SPRAY? OR AEROSOL OR DUST? OR POWDER? OR GRANUL?)/ABDT.DOS S FILTER?/ABDT.DRWD S (POLYMER AND RESIN?)/ABDT.EMB	AB ABDT ²⁾ ABDT ²⁾ ABDT ²⁾ ABDT ²⁾ ABDT ²⁾ ABDT ²⁾ ABDT ²⁾ ABDT ²⁾ ABDT ²⁾ ABDT ²⁾ ABDT ²⁾ ABDT ²⁾

(続く)

- 1) 抄録フィールド (/AB) には、公報レベルの著者抄録も含まれます。ただし、基本索引フィールドには公報レベルの著者抄録は含まれません。
- 2) このフィールドは WPIX ファイルでのみ表示可能です (ABDT は DW1995-1999 年, ABEX は DW199908 以降のレコードに収録されています)。

検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/ABDT. EX	ドキュメンテーション抄録, Example	S BIODEGRAD?/ABDT. EX	ABDT ²⁾
/ABDT. FS	ドキュメンテーション抄録, First Section	S NYLON/ABDT. FS	ABDT ²⁾
/ABDT. GEN	ドキュメンテーション抄録, General	S RARE EARTH/ABDT. GEN	ABDT ²⁾
/ABDT. INO	ドキュメンテーション抄録, Inorganic Chemistry	S (FIBER OR RESIN)/ABDT. INO	ABDT ²⁾
/ABDT. MAT	ドキュメンテーション抄録, Specific Materials	S VINYL?/ABDT. MAT	ABDT ²⁾
/ABDT. MS	ドキュメンテーション抄録, More Specifically	S (F OR CI)/ABDT. MS	ABDT ²⁾
/ABDT. NOV	ドキュメンテーション抄録, Novelty	S (SHEET OR FABRIC)/ABDT. NOV	ABDT ²⁾
/ABDT. ORG	ドキュメンテーション抄録, Organic Chemistry	S TETRAHYDROFURAN/ABDT. ORG	ABDT ²⁾
/ABDT. PN	ドキュメンテーション抄録, Patent Number	S US1368/ABDT. PN	ABDT ²⁾
/ABDT. PRE	ドキュメンテーション抄録, Preferred	S BUTYROLACTON?/ABDT. PRE	ABDT ²⁾
/ABDT. PRP	ドキュメンテーション抄録, Preparation	S IMIDAZOL?/ABDT. PRP	ABDT ²⁾
/ABDT. SUB	ドキュメンテーション抄録, Specific Compounds	S MALEIC/ABDT. SUB	ABDT ²⁾
/ABDT. TECH	ドキュメンテーション抄録, Technology Focus	S (LAYER? OR COAT?)/ABDT. TECH	ABDT ²⁾
/ABDT. UADV	ドキュメンテーション抄録, Use/Advantage	S (TAST? OR EAT?)/ABDT. UADV	ABDT ²⁾
/ABDT. USE	ドキュメンテーション抄録, Use	S ((DERM? OR SKIN?) AND AGE?)/ABDT. USE	ABDT ²⁾
/ABDT. WD	ドキュメンテーション抄録, Wider Disclosure	S BLOOD?/ABDT. WD	ABDT ²⁾
/ABEX	拡張抄録 *	S ?FERMENT?/ABEX	ABEX ²⁾
/ABEX. ADM	拡張抄録, Administration *	S KINASE?/ABEX. ADM	ABEX ²⁾
/ABEX. DEF	拡張抄録, Definition *	S ?ALKYL?/ABEX. DEF	ABEX ²⁾
/ABEX. EX	拡張抄録, Example *	S (NUC? AND COMPLEX?)/ABEX. EX	ABEX ²⁾
/ABEX. PRI	拡張抄録, Priority *	S METABOLIC/ABEX. PRI	表示されない
/ABEX. SC	拡張抄録, Specific Compounds *	S ?NITRO?/ABEX. SC	ABEX ²⁾
/ABEX. WD	拡張抄録, Wider Disclosure *	S KINASE?/ABEX. WD	ABEX ²⁾
/AC	出願国 ^{3), 4)}	S GB/AC (P) 1999/AY	ADT, AI
/ACTN	Mechanism of Action *	S CYTOKINES/ACTN	ACTN, AB
/ACTV	Activity *	S ANTIBIOTIC ACTIVITY/ACTV	ADT, AI
/AD	出願日 ^{3), 4), 5)}	S JAN 1993-APR 1993/AD (P) FR/AC S 19930101-19930430/AD (P) FR/AC	ADT, AI
/ADV	Advantage *	S LASER BEAM?/ADV S ?NITRI?/ADV	ADV, AB

(続く)

2) このフィールドは WPIX ファイルでのみ表示可能です (ABDX は DW1995-1999 年, ABEX は DW199908 以降のレコードに収録されています)。

3) 同一出願に由来する出願データをリンクして検索するときには (P) 演算子で検索します。

4) 一つの特許の特許情報 (特許番号, 特許発行国, 特許種別のみ) と出願情報は (P) 演算子によってリンクして検索できます。

5) 数値演算子または範囲指定検索が可能な数値検索フィールドです。

検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/AN	レコード番号	S 2008-B12345/AN	AN
/ANX	追加レコード番号	S 1980-B7362C/ANX	ANX, CR
/AP	出願番号 ^{3), 4), 6)}	S 1989GB-000219641/AP S GB1989-219641/AP	ADT, AI
/AP. PKC	ダウエント出願番号種別コード	S ATA62/AP. PKC	ADT
/AP. YR	出願番号, 年 ^{3), 4)}	S 2004/AP. YR	ADT, AI
/APT	出願タイプ ^{3), 4)}	S RELATED TO/APT	ADT, AI
/AY	出願年 ^{3), 4), 5)}	S 2004-2005/AY	ADT, AI
/CPC	共通特許分類	S D03D0015-0011/CPC	CPC
/CPC. ACD	共通特許分類, 発行日	S 20130101/CPC. ACD	CPC. TAB
/CPC. KW	共通特許分類, キーワード	S INVENTION/CPC. KW	CPC. TAB
/CPC. VER	共通特許分類, 版	S 20130101/CPC. VER	CPC. TAB
/CR	クロスリファレンス	S 1990-001459/CR	CR, XR
または /XR			
/CYC	特許発行国数 ⁵⁾	S 20-30/CYC	CYC
/DC	ダウエントクラス ⁷⁾	S A25/DC	DC
/DETD	Detailed Description *	S NAPHTHALENE?/DETD	DETD, AB
/DLVL	ドキュメントレベル	S L1 (L) INVENTION/DLVL	表示されない
/DNC	第二次アクセス番号 CPI	S C1993-056092/DNC	DNC
/DNN	第二次アクセス番号 CPI 以外	S N1983-041955/DNN	DNN
/DRWD	Drawing Description *	S ?TANGUL?/DRWD	DRWD, AB
/DRWN	図面の数 ⁵⁾	S DRWN=9	DRWN, PI
/DS	指定国 ⁸⁾	S BE/DS (P) 1999/PY	DS, PI
/DT	資料種類 (コードおよび資料名)	S L7 AND P/DT S L7 AND UTILITY MODEL/DT	表示されない
/DUPD	Clarivate Analytics アップデート (入力時の DW と 最新の DW) ⁵⁾	S 197007/DUPD	DUPD
/DW	ダウエントアップデート ^{5), 8)}	S 199908/DW S 199901-199915/DW (P) FR/PC	PI
/DW. AN	レコード番号が付与されたダウエントアップデート週 (補遺)	S 197022/DW. AN	AN
/DW. B	ダウエントアップデート, Basic 特許 ^{5), 8)}	S 199915/DW. B (P) US/PC. B	PI. B, PI
/ED	入力日 ⁵⁾	S ED>20060210 AND L10	ED
/EPC (/ECLA, /EPCLA)	ヨーロッパ特許分類	S A01B0015-20/EPC	EPC, ECLA, EPCLA
/EPC. KW	ヨーロッパ特許分類, キーワード	S D2/EPC. KW	EPC, ECLA, EPCLA
/FA または /FAS	フィールドの存在	S L7 NOT NOAB/FA S L11 AND GI/FA	FA

(続く)

- 3) 同一出願に由来する出願データをリンクして検索するときには (P) 演算子で検索します。
- 4) 一つの特許の特許情報 (特許番号, 特許発行国, 特許種別のみ) と出願情報は (P) 演算子によってリンクして検索できます。
- 5) 数値演算子または範囲指定検索が可能な数値検索フィールドです。
- 6) これらの番号はダウエント形式および STN 形式のどちらでも検索できます。
- 7) ダウエントクラスはテキスト形式では EXPAND することはできませんが検索はできません。
- 8) 同一特許に由来する特許データをリンクして検索するときには (P) 演算子で検索します。

検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/FACL	FI (追加分類)	S A61K0008-19/FACL	FCL
/FCL	FI	S A61K0006-00 A/FCL	FCL
/FDT	出願経過の詳細 ^{3), 4), 6)}	S US5072794/FDT S EP----105613/FDT	FDT
/FDT. PC	出願経過の詳細, 特許発行国 ^{3), 4)}	S AUSTRIA/FDT. PC	FDT
/FDT. PK	出願経過の詳細, 特許種別コード ^{3), 4)}	S CZA/FDT. PK	FDT
/FDT. PN または /RLPN	出願経過の詳細, 特許番号 ^{3), 4)}	S JP6058386/FDT. PN	FDT
/FDT. TP	出願経過の詳細, 出願タイプ ^{3), 4)}	S REISSUE OF/FDT. TP	FDT
/FICL	FI (インデキシング)	S A61K0031:045/FICL	FCL
/FMCL	FI (主分類)	S D21C0009-10/FMCL	FCL
/FSCL	FI (副分類)	S G01B0003-10 101/FSCL	FCL
/FS	ファイルセグメント	S PLASMA AND EPI/FS	FS
/FTRM	F ターム	S 5B001/AA01/FTRM	FTRM
(/FTERM, /FTCLA, /JPCLA)			
/IC ⁹⁾	国際特許分類 (IPC) ⁶⁾ (主分類および副分類)	S C09K007/IC S C09K007-02/IC S C09K-007-02/IC S D01D005-08?/IC	IC, IPC
/ICA ⁹⁾	国際特許分類, 追加分類 ⁶⁾ (参考情報記号)	S A01K067-027/ICA	ICA
/ICI ⁹⁾	国際特許分類, インデキシング コード (相補情報記号) ⁶⁾	S B03D103:08/ICI	ICI
/ICM ⁹⁾	国際特許分類, 主分類 ⁶⁾	S C09K007-02/ICM	ICM
/ICO	コンピュータ分類 (EPO)	S K61M/ICO	ICO
/ICO. KW	コンピュータ分類, キーワード	S MANOL/ICO. KW	ICO
/ICS ⁹⁾	国際特許分類, 副分類 ⁶⁾	S D01B001-38/ICS	ICS
/IN	発明者名	S HALE, A H/IN S HALE A H/IN, PA	IN
または /AU		S C12P0021-08/IPC S C12!/IPC	IPC
/IPC	国際特許分類, 全 IPC ^{6), 10)} (ICA, ICI, ICM, ICS, IPCI, IPCR, IICM, IICS, IICA, IICI)	S C12P0021/IPC	
/IPC. ACD	国際特許分類, 発行日 ⁵⁾	S IPC. ACD>20070107	IPC. TAB
/IPC. KW	国際特許分類, キーワード	S ADDITIONAL/IPC. KW	IPC. TAB
/IPC. REF	国際特許分類, リフォーム ⁶⁾	S A01B0003-44/IPC. REF	IPCI, IPCR
/IPC. VER	国際特許分類, 版 ⁵⁾	S 20080101/IPC. VER	IPC. TAB
/LA	言語 ⁸⁾ (コードおよびテキスト)	S FR/LA (P) EP/PC S FRENCH/LA (P) EP/PC (P) 1999/PY	PI
/MC	マニュアルコード ^{10), 11)}	S X11-A01A1/MC	MC
/MCN	マルクーシュ化合物番号	S 0153-12201-CL/MCN	MCN, CMC
/MGR	国際特許分類, メイングループ の範囲指定検索用 ^{5), 6)}	S C09K/ICM(T)18-20/MGR	表示されない

(続く)

- 3) 同一出願に由来する出願データをリンクして検索するときには (P) 演算子で検索します。
- 4) 一つの特許の特許情報 (特許番号, 特許発行国, 特許種別のみ) と出願情報は (P) 演算子によってリンクして検索できます。
- 5) 数値演算子または範囲指定検索が可能な数値検索フィールドです。
- 6) これらの番号はダウエント形式および STN 形式のどちらでも検索できます。
- 9) このフィールドには, 改定前 IPC (第 7 版までの IPC) が収録されています。このフィールドは, 改定後の IPC (第 8 版の IPC) では更新されません。レコード中の全 IPC を検索するには /IPC フィールドを使用してください。
- 10) このフィールドではシソーラスが利用できます。

検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/NCL	米国特許分類	S 002006700/NCL	NCL
/NCLM	米国特許分類, 主分類	S 002/NCLM	NCL
/NCLS	米国特許分類, 副分類	S 004/NCLS	NCL
/NOV	Novelty ¹²⁾ *	S EXCITATION LIGHT/NOV	NOV, AB
/PA	特許出願人 ¹³⁾	S SHELL OIL/PA	PA
または /CS		S "NEW YORK WIRE"?/PA	
/PACO	特許出願人コード ^{10), 14)}	S SHEL/PACO	PA
/PC	特許発行国 ^{4), 8), 15)} (コードおよび国名)	S GB/PC (P) 1999/AY	PI
/PC. B	特許発行国, Basic 特許 ^{8), 15)}	S UNITED KINGDOM/PC	
/PD	発行日 ^{5), 8)}	S GB/PC. B (P) JUNE 1992/PD. B	PI. B, PI
		S 19900404/PD	PI
/PD. B	発行日, Basic 特許 ^{5), 8)}	S 1 APR 1999-15 APR 1999/PD (P) GB/PC	
/PGN	ページ数 ⁵⁾	S 19930330/PD. B (P) US/PC. B	PI. B, PI
/PK	特許種別コード ^{4), 8), 16)}	S PGN=5	PI
		S HU?/PK	PI
/PK. B	特許種別コード, Basic 特許 ^{8), 16)}	S EPA2/PK (P) DE/DS	
		S EPA?/PK. B	PI. B, PI
/PN	特許番号 ^{4), 6), 8)}	S EPA1/PK. B (P) 1991-1992/PY. B	
		S US5198416/PN	PI
		S EP-----100323/PN	
		S EP0100323/PN	
		S EP100323/PN	
		S US20060000001/PN	
		S US-20060000001/PN	
/PN. B	特許番号, Basic 特許 ^{6), 8)}	S US5198416/PN. B	PI. B, PI
/PNC	特許番号数 ⁵⁾	S 5-10/PNC	PNC
/PNK	種別付き特許番号	S W02009006253A2/PNK	PNK
/PNK. B	種別付き特許番号, Basic 特許	S TH43458A/PNK. B	PNK. B
/PRC	優先権主張国 ¹⁷⁾	S FR/PRC	PRAI
		S GB/PRC (S) 1990/PRY	
/PRCF	最先の優先権主張国	S AU/PRCF	PRAI
/PRD	優先権主張日 ^{5), 17)}	S 20010930/PRD	PRAI
		S JUNE 1991/PRD (S) FR/PRC	
/PRDF	最先の優先権主張日 ^{5), 17)}	S JUNE 2002/PRDF	PRAI
/PRN	優先権出願番号 ^{6), 17)}	S 1988US-000252206/PRN	PRAI
		S US1988-252206/PRN	
		S 1990DE-000001059/PRN	
		S DE1990-1059/PRN	
/PRN. YR	優先権出願番号, 年	S 2005/PRN. YR	PRAI
/PRNF	最先の優先権出願番号	S AL 1961-8036/PRNF	PRAI
/PRY	優先権主張年 ^{5), 17)}	S 1990-1991/PRY (S) NL/PRC	PRAI
/PRYF	最先の優先権主張年, ^{5), 17)}	S 1992/PRYF	PRAI

(続く)

- 4) 一つの特許の特許情報 (特許番号, 特許発行国, 特許種別のみ) と出願情報は (P) 演算子によってリンクして検索できます。
- 5) 数値演算子または範囲指定検索が可能な数値検索フィールドです。
- 6) これらの番号はダウエント形式および STN 形式のどちらでも検索できます。
- 8) 同一特許に由来する特許データをリンクして検索するときには (P) 演算子で検索します。
- 10) このフィールドではシソーラスが利用できます。
- 12) ダウエントアップデート 199908 以降のデータに収録されています。
- 13) このフィールドでは, (S) 演算子はスペースで代用できます。フレーズで検索するときには, 引用符で囲んで検索します。
- 14) /PACO フィールドのシソーラスを用いて, 特許出願人コードと特許出願人名の対応を表示できます。
- 15) => [HELP COUNTRY](#) と入力すると, 収録国の情報を表示できます。
- 16) => [HELP KIND](#) と入力すると特許種別コードのリストを表示できます。
- 17) 同一出願に由来する優先権データをリンクして検索するときには, (S) 演算子で検索します。

検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/PT	特許タイプ	S EQUIVALENT/PT AND BE/PC	PI
/PY	発行年 ^{5),8)}	S 1998-1999/PY	PI
/PY.B	発行年, Basic 特許 ^{5),8)}	S 1998/PY.B(P)JP/PC.B	PI.B, PI
/SGR	国際特許分類, サブグループの 範囲指定検索用 ^{5),6)}	S C09K007/ICM(T)100-2000/SGR S F01B-007/IC(T)10000-12000/SGR	表示されない
/SL	抄録の言語 (コードおよび国名)	S L1 AND EN/SL	SL
/TECH	Technology Focus ¹²⁾ *	S DYEING AGENT#/TECH	TECH
/TI	標題 *	S DRILLING FLUID#/TI	TI
/TT	タイトルターム ^{10),18)} (追加語 (AW) を含む)	S DRILL FLUID/TT S FIBRE-OPTIC/TT	TT
/UADV	Use/Advantage *	S TREATMENT/UADV	UADV, AB
/UP	更新日 ⁵⁾	S L7 AND 20061001-20061031/UP	UP
/UPA	ポリマー索引の更新日 ⁵⁾	S UPA=APR 2005	UPA
/UPAB	抄録の更新日 ⁵⁾	S MAR 2006-JUN 2006/UPAB AND L10	UPAB
/UPB	ケミカルコードの更新日 ⁵⁾	S UPB=APR 2005	UPB
/UPDA	ドキュメンテーション抄録の 更新日 ⁵⁾	S MAR 2006/UPDA	UPDA
/UPEQ	対応特許の更新日 ⁵⁾	S 20060825/UPEQ	表示されない
/UPGI	図面イメージの更新日 ⁵⁾	S UPGI=APR 2006	表示されない
/UPIC	国際特許分類の更新日	S 20090918/UPIC	UPIC
/UPIN	発明者の更新日	S UPIN=3 MAY 2013	UPIN
/UPIT (/UPKW)	索引の更新日 ⁵⁾	S 20060412/UPIT(/UPKW)	UPIT
/UPP	新規レコード入力日および 対応特許の更新日 ⁵⁾	S FEB 2006-JUN 2006/UPP	UPP
/UPPA	特許出願人の更新日 ⁵⁾	S 20060426/UPPA AND L15	UPPA
/UPPI	特許情報の更新日 ⁵⁾	S UPPI=JAN 2006	UPPI
/UPPR	優先権情報の更新日 ⁵⁾	S UPPR>=JULY 2006	UPPR
/UPTI	標題の更新日 ⁵⁾	S 20060323/UPTI AND L2	UPTI
/USE	Use *	S ?PHENYLETHER?/USE	USE, AB

5) 数値演算子または範囲指定検索が可能な数値検索フィールドです。

6) これらの番号はダウエント形式および STN 形式のどちらでも検索できます。

8) 同一特許に由来する特許データをリンクして検索するときには (P) 演算子で検索します。

10) このフィールドではシソーラスが利用できます。

12) ダウエントアップデート 199908 以降のデータに収録されています。

18) このフィールドでは、優先語や非優先語 (USE, UF) などが EXPAND と SEARCH で利用できます。

スーパー検索フィールド

必要な情報が含まれる一つまたはそれ以上のフィールドを検索するときは、スーパー検索フィールドを利用します。スーパー検索フィールドを利用すると、クロスファイルおよびマルチファイル検索が簡単に実行できます。スーパー検索フィールドで EXPAND は利用できません。代わりに個々のフィールドで EXPAND してください。

スーパー検索フィールド	検索されたフィールド	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/APPS	/AP, /PRN	特許出願番号および 優先権出願番号 ¹⁾	S 1989GB-0219641/APPS S GB1989-219641/APPS	ADT, AI, PRAI
/DN	/DNC, /DNN	第二次アクセス番号	S C93-056092/DN	DN, DNC, DNN
/MALL	/M0, /M1, /M2, /M3, /M4, /M5, /M6	ケミカルコード, 全てのサブフィールド ²⁾	S A100/MALL	M0-M6, CMC
/PATS	/FDT, /PN	特許番号グループ ¹⁾	S GB2223255/PATS S EP-100323/PATS	FDT, PI
/PCS	/DS, /PC	特許発行国および指定国 ³⁾ (コードおよび国名)	S ES/PCS S SPAIN/PCS	PI, DS

- 1) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。
- 2) WPIDS, WPIX ファイルでのみ利用可能です。
- 3) => HELP COUNTRY と入力すると、収録国の情報を表示できます。

検索フィールド (公報レベル)

中間一致および後方一致可能なフィールドはアスタリスク (*) で示してあります。

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/BIEX	拡張基本索引 * (公報レベルの著者標題, 著者抄録, クレーム)	S NANOCLUSTER#/BIEX	ABDE, ABEN, ABES, ABFR, ABOL, CLMEN, CLMDE, CLMFR, TIDE, TIEN, TIES, TIFR
/ABDE	抄録, オリジナル (ドイツ語) *	S ?AUTOMATISERT?/ABDE	ABDE
/ABEN	抄録, オリジナル (英語) *	S ?CONDUCTIVE MATERIAL/ABEN	ABEN
/ABES	抄録, オリジナル (スペイン語) *	S AUTOMOVIL?/ABES	ABES
/ABFR	抄録, オリジナル (フランス語) *	S ?MOBILIS?/ABFR	ABFR
/ABOL	抄録, オリジナル (その他の言語) *	S ?MOLECUL?/ABOL	ABOL
/AG	代理人 ¹⁾	S PFIZER/AG	AG
/AG. T	代理人 (全データ)	S (PFIZER(W) INC)/AG. T	AG. T
/AGA	代理人住所	S NEWCASTLE/AGA	AGA
/AGA. CNY	代理人住所, 国 (コード)	S NL/AGA. CNY	AGA
/AGA. CTY	代理人, 市	S (MUNICH OR MUENCHEN)/AGA. CTY	AGA
/AN. PUB	レコード番号, 公報レベル	S 2005-262794/AN. PUB	AN. PUB
/APTS	出願情報 (Clarivate Analytics)	S FR2005-3462/APTS	APTS
/CLM	クレーム *	S BUEROSTUHL/CLM S PROCEDE DE TEINTURE/CLM S ?CHAIR?/CLM	CLMEN, CLMDE, CLMFR
/FA. M	フィールドの存在 (公報レベル)	S ABDE/FA. M	FA. M
/IIC ³⁾	国際特許分類, 発行時 (主分類, 副分類) ²⁾	S A01B001/IIC	IIC

(続く)

- 1) このフィールドでは、(S) 演算子はスペースで代用できます。フレーズで検索するときには、引用符で囲んで検索します。
- 2) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。
- 3) 個のフィールドでは、改定前 IPC (第 7 版までの IPC) が収録されています。このフィールドは、改定後の IPC (第 8 版の IPC) では更新されません。レコード中の全 IPC を検索するには /IPC フィールドを使用してください。

検索フィールド（公報レベル）（続き）

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/IICA ³⁾	国際特許分類，発行時，追加分類 (参考情報記号) ²⁾	S A01B003-36/IICA	IICA
/IICI ³⁾	国際特許分類，発行時，インデキ ングコード（相補情報記号） ²⁾	S B03D103:08/IICI	IICI
/IICM ³⁾	国際特許分類，発行時，主分類 ²⁾	S A61K038-48/IICM	IICM
/IICS ³⁾	国際特許分類，発行時，副分類 ²⁾	S C07K014-01/IICS	IICS
/IN.NAT	発明者，国籍	S AT/IN.NAT	INA
/IN.RES	発明者，所在地（コード）	S BE/IN.RES	INA
/IN.T	発明者（全データ）	S BLAKE/IN.T	IN.T
/INA	発明者住所	S HEIDELBERG/INA	INA
/INA.CNY	発明者住所，国（コード）	S DE/INA.CNY	INA
/INA.CTY	発明者住所，市	S WIEN/INA.CTY	INA
/INCL	米国特許分類，発行時	S D01125000/INCL	INCL
/INCLM	米国特許分類，発行時，主分類	S D24225000/INCLM	INCL
/INCLS	米国特許分類，発行時，副分類	S PLT001000/INCLS	INCL
/INO	発明者，オリジナル	S MAYER DALE J/INO	INO
/INO.FNM	発明者，オリジナル，名	S DENNIS ALBERT/INO.FNM	INO
/INO.SNM	発明者，オリジナル，姓	S SCHEKINEN/INO.SNM	INO
/IPC	国際特許分類	S A01B003-36/IPC	IPC
/IPC.ACD	国際特許分類，発行日 ⁴⁾	S 20060101/IPC.ACD	IPC.TAB.M
/PA.LIM	特許出願人，国（コード）	S DE/PA.LIM	HIT
/PA.NAT	特許出願人，国籍（コード）	S BE/PA.NAT	HIT
/PA.RES	特許出願人，所在地（コード）	S DE/PA.RES	HIT
/PA.T	特許出願人（全データ）	S BASF AG/PA.T	PA.T
/PAA	特許出願人住所	S MUENCHEN?/PAA	PAA
/PAA.CNY	特許出願人住所，国（コード）	S BE/PAA.CNY	PAA
/PAA.CTY	特許出願人住所，市	S MUNICH/PAA.CTY	PAA
/PAO	特許出願人，オリジナル ¹⁾	S 3M COMPANY/PAO	PAO
/PRC.B	優先権主張国，Basic 特許 (コードおよびテキスト)	S AR/PRC.B	PRAI
/PRD.B	優先権主張日，Basic 特許 ⁴⁾	S 19980101-19980301/PRD.B	PRAI
/PRN.B	優先権番号，Basic 特許 ²⁾	S AR1968-214388/PRN.B	PRAI
/PRTS	優先権情報 (Clarivate Analytics)	S 1977JP-000000061/PRTS	PRTS
/PRY.B	優先権主張年，Basic 特許 ⁴⁾	S 1998/PRY.B	PRAI
/SL.M	抄録の言語（公報レベル） (コードおよびテキスト)	S FR/SL.M	SL.M
/TIDE	原標題（ドイツ語）	S FRUCHTFLEISCH/TIDE	TIDE
/TIEN	原標題（英語）	S PLANT PRODUCT/TIEN	TIEN
/TIES	原標題（スペイン語）	S BIOLOGICO/TIES	TIES
/TIFR	原標題（フランス語）	S FRUIT##/TIFR	TIFR
/TL	標題言語 (コードおよびテキスト)	S L1 AND EN/TL	TL
/UPAA	著者抄録の更新日 ⁴⁾	S MAR 2006/UPAA	HIT, ABEN, ABDE, ABFR 表示されない
/UPAT	著者標題の更新日 ⁴⁾	S 21 APR 2006/UPAT	表示されない
/UPCL	クレームの更新日 ⁴⁾	S 20060510/UPCL	HIT, CLM 表示されない
/UPIO	国際特許分類の更新日，発行時 ⁴⁾	S UPIO=13 APR 2006	表示されない
/UPNO	米国特許分類の更新日，発行時 ⁴⁾	S UPNO=20060421	表示されない

で囲んで検索します。

2) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。

3) このフィールドでは，改定前 IPC（第 7 版までの IPC）が収録されています。このフィールドは，改定後の IPC（第 8 版の IPC）では更新されません。レコード中の全 IPC を検索するには /IPC フィールドを使用してください。

4) 数値演算子または範囲指定検索が可能な数値検索フィールドです。

DCR の 検索フィールド

中間一致および後方一致可能なフィールドはアスタリスク (*) で示してあります。

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/AN. S	DCR レコード番号, DCR セグメント	S DCR-100174/AN. S	AN. S
/CC	分類コード (物質ディスクリプタ)	S HALOCARBONS/CC	CC
/CMF または /FRAGMF	成分分子式	S C H3 F6 P *1/CMF	SMF
/CMT	注記	S FIBROBLAST##/CMT	CMT
/CN	化学物質名	S TAXOL/CN	CN
/CN. P	優先化学物質名	S D-GLUCOSE-6-PHOSPHATE/CN. P	CN. P, CN
/CN. S	統制化学物質名	S DECANE-1, 10-DISULFONYL DIAZIDE/CN. S	CN. S, CN
/CNS	化学物質名セグメント * (優先化学物質名 (CN. P), 統制化学物質名 (CN. S), および同義名 (SY) からの 名称セグメント)	S DISULFONYL DIAZIDE/CNS	CN
/CT	DDF 統制語	S MAO-INHIBITOR/CT	CT
/CT. DA	DDF 統制語, 薬効	S MAP-KINASE-INH?/CT. DA	CT
/CT. MA	DDF 統制語, 作用機序	S ADRENALINE/CT. NA	CT
/DDRN	ダウエントドラッグ登録名	S GALACTOSE/DDRN	DDRN
/DCSE	DCR 番号, DCR セグメント	S 70-0-0-0/DCSE	DCSE
/EDCR	DCR 入力日 ¹⁾	S 19990707/EDCR	EDCR
/ELS	元素記号	S (N AND S)/ELS	SMF
/ELS. CNT	元素記号の数 ¹⁾	S 0/ELS(S)7/ELS. CNT	SMF
/FRAGMF または /CMF	フラグメント分子式	S AL *154/FRAGMF	SMF
/MF	分子式	S H CL . C20 H16 N4 O2/MF	MF
/MW	分子量 ¹⁾	S L7 AND 170-210/MW	MW
/NC	成分数 ¹⁾	S 9-11/NC	SMF
/NFRAG	フラグメント数 ¹⁾	S 4/NFRAG AND L11	SMF
/SCR または /SXR	構造クロスリファレンス	S 100006 : SEE ALSO/SCR	SCR
/SDCN	ダウエント化合物番号, DCR セグメント ²⁾	S R20123/SDCN	SDCN
/SDRN	ダウエント登録番号, DCR セグメント ²⁾	S 1029/SDRN	SDRN
/SMF	標準化された分子式	S "B *1; SI *1; TOTAL *2; TYPE *2"/SMF	SMF
/SRIN	リングインデックス番号, DCR セグメント ²⁾	S 11895/SRIN	SRIN
/SS	部分構造用語	S PHOSPHONIC-ACID/SS	SS
/SY または /CN	同義名	S FALUBIN/SY	SY
/UPCR	DCR 更新日 ^{1), 3)}	S JUN 1999/UPCR	UPCR
/UPWX	WPI クロスリファレンス更新日 ^{1), 4)}	S 19990719/UPWX	UPWX

1) 数値演算子または範囲指定検索ができる数値検索フィールドです。

2) 書誌レコードの索引へのクロスリファレンス. SDCN, SDRN, SRIN フィールドのデータを抽出し, それぞれ /DCN, /DRN, /RIN フィールドで検索すると, 対応する書誌レコードが得られます. なお, DCR セグメントに収録されている化学物質に関する書誌レコード (特許情報) を検索する場合には, => S L1/DCR で検索します (L1 は DCR セグメントの検索結果).

3) UPCR は DCR セグメントに新しい化学物質が入力された日付です。

4) UPWX は書誌レコードに化学物質が索引された日付です. UPWX は, DCR ファイルセグメントでのアラート (自動 SDI 検索) に利用できます。

化学物質およびポリマー索引の検索フィールド

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/DC /DCN	ダウエントクラス ¹⁾ ダウエント化合物番号 ^{2),3)}	S A25/DC S R10034-M/DCN S R10034/DCN	DC CMC, DCN
/DCR または /DCRE /DRN	DCR レコード番号, DWPI セグメント ⁴⁾ ダウエント登録番号 ^{3),5),6)}	S L10/DCR S 7/DCRE S 5107-U/DRN S 5107/DRN S CAPROPYL PEROXIDE+USE/DRN S 503 54& 600 609/FG	IT, CMC, PLE CMC, DRN
/FG または /AM /IT または /KW /KS	フラグメンテーションコード (PLASDOC) ^{6),7),8)} 索引 ⁹⁾ (DCR 番号を含む) プラスドックキーシリアル 番号 ^{3),6),7),8),10)}	S 7-PRD/IT S (87874(T)PRD)/IT S 2017 2020 2296 2575/KS	PLC, FG IT, KW PLC, KS
/MC /MCN /M0-/M6 /PLE	マニュアルコード ^{3),11)} マルクーシュ化合物番号 ケミカルコード ^{6),7)} 新ポリマー索引 ^{3),6),12)}	S A12-W10A/MC S 8944-01501-P/MCN S B713 G012 H600 L399 M903/M3 S (G1854(S)D10)/PLE S ((P0737(P)S1672)(L)B4171)/PLE	MC CMC, MCN M0-M6, CMC PLE
/RIN /UPA /UPB /UPIT または/UPKW	リングインデックス番号 ^{6),13)} ポリマー索引の更新日 ^{6),14)} ケミカルコードの更新日 ^{6),14)} 索引の更新日 ¹⁴⁾	S 50736/RIN S L4 AND MAR 2006/UPA S UPB>20060310 AND L2 S 20061005/UPIT	CMC, RIN UPA UPB UPIT, UPKW

- 1) ダウエントクラスの分類名は、コードを EXPAND することによって表示させることができます。なお、検索にはコードを利用します。
- 2) ダウエント化合物番号は関連のある M1-M6 のケミカルコードと (P) 演算子にてリンクされています。さらに、ケミカルコードフィールド (/Mx) で直接検索することもできます。ダウエント化合物番号の定義は、EXPAND コマンドで確認することができます。コードに +UF/DCN を付けて EXPAND すると、定義が表示されます。化合物名に +USE/DCN をつけて EXPAND すると、コードが表示されます。
- 3) このフィールドではシソーラスが利用可能です。
- 4) /DCR フィールドは、S L10/DCR のように、DCR セグメントの検索結果を使って書誌セグメントを検索するときに利用します。L10 は DCR セグメントの検索結果で、L10/DCR で L10 の集合に含まれる化学物質に関する書誌レコードを検索します。
- 5) ダウエント登録番号の定義は、EXPAND コマンドで確認することができます。コードに +UF/DRN を付けて EXPAND すると、定義が表示されます。また、化合物名に +USE/DRN を付けて EXPAND すると、対応するコードが表示されます。
- 6) WPIDS, WPIX ファイルでのみ利用可能です。
- 7) このフィールドでは (P) 演算子はスペースで代用できます。
- 8) /FG および /KS フィールドはダウエントアップデート 199401 をもって中止され、/PLE フィールドに代わりました。
- 9) このフィールドには、DCR 番号とロールが含まれ、これらのデータは (T) 演算子にてリンクしています。ロールコードの定義は、HELP ROLES で確認できます。
- 10) /KS フィールドでの検索でキーシリアルコードを用いると、定義が自動的に表示されます。
- 11) マニュアルコードで検索すると定義が自動的に表示されます。
- 12) /PLE フィールドはダウエントアップデート 199332 から、/FG および /KS フィールドに代わって利用できます。このフィールドは、三種類のレベルの違う演算子 -(S) 一番狭い、(P) 中間、(L) 広い - でリンクできます。新ポリマー索引のシソーラスは /PLE フィールドで利用可能です。
- 13) リングインデックス番号は CMC フィールド中でケミカルコードと (P) 演算子にてリンクされており、ダウエントアップデート 198601 からは、特に各々の CMC サブフィールドとリンクされています。特にリンクされているリングインデックス番号は、ケミカルコードフィールド (/Mx) で直接検索でき、各々の CMC サブフィールドの下に表示されます。
- 14) 数値演算子または範囲指定検索ができる数値検索フィールドです。

構造の質問式

構造検索では、DCR セグメントが検索されます。

質 問 式	検 索 例
STRUCTURE コマンドまたは STN Express/STN on the Web のアップロード機能を用いて作成された構造質問式の L 番号 (L 番号間のブール演算も可能)	SEARCH L1 FAM FULL SEA L1 AND L2 SSS
SCREEN コマンドにより作成されたスクリーンセットの L 番号 (L 番号間のブール演算も可能)	S L3 OR L4 SSS FULL
STRUCTURE コマンドまたは STN Express/STN on the Web のアップロード機能を用いて作成された構造質問式の L 番号と SCREEN コマンドにより作成されたスクリーンセットの L 番号の組み合わせ (L 番号間のブール演算も可能)	S L1 AND L2 NOT L3

構造検索の種類

種 類	内 容	SEARCH コード	入 力 例
Substructure 部分構造検索 (デフォルト)	構造質問式を満足する物質を検索 置換可能なすべての位置に追加の 置換基が結合してもよい 他の成分が含まれていてもよい	SSS	SEARCH L1 SSS FULL S L2 OR L3 SSS S L7 SSS
Closed Substructure 閉構造部分構造検索	構造質問式に完全に一致する物質を検索 置換を許容したすべての位置に置換基 が結合してもよい 他の成分が含まれてもよい	CSS	SEARCH L1 CSS FULL S L2 NOT L3 CSS S L4 OR L5 CSS
Family ファミリー検索	構造質問式に完全に一致する物質を検索 他の成分が含まれてもよい	FAM	S L6 FAM SAM
Exact 完全一致検索	構造質問式に完全に一致する物質を検索	EXA	SEA L5 EXA FUL

構造検索の範囲

種 類	内 容	SEARCH コード	入 力 例
Sample ¹⁾ (デフォルト)	ファイルの固定された一部 (10%) を検索	SAM	S L6 SSS SAM
Full	ファイル全体 (100%) を検索	FUL	S L5 OR L8 SSS FUL
Subset Sample ¹⁾	一度検索して得られた結果をサブセットとして、その集合の一部を検索	SUB SAM	S L7 SSS SUB=L5 SAM
Subset Full	一度検索して得られた結果をサブセットとして、その集合全体 (100%) を検索	SUB FUL	S L7 SSS SUB=L5 FUL

1) SET EXTEND 機能は、サンプル検索では機能しません。

物性検索フィールド 1), 2), 3), 4) 5)

SEARCH コード	物性	SEARCH 例	デフォルト 単位 ⁵⁾
/AOS	物質量	S 10/AOS	mol
/BIR	ビットレート	S 100000-160000/BIR	bit/s
/BIT	保存情報	S BIT>3 MEGABIT (10A) STORAGE	bit
/CAP	静電容量	S 1-10 MF/CAP	F
/CDN	電流密度	S CDN>10 A/M**2	A/m ²
/CMOL	モル濃度	S MOLYBD?/BI (S) 2/CMOL	mol/L
/CON	コンダクタンス	S 1E-2/CON	S (Siemens)
/DB	デシベル	S DB>50	dB
/DEG	角度	S (POLARI? (S) ANGLE)/BI (S) 45/DEG	° (degree)
/DEN	密度, 質量濃度	S (CELL? (S) RECOMBIN?)/CLM (S) 5E-3-10E-3/DEN	kg/m ³
/DEQ	線量当量	S DEQ>0.5 (S) RADIATION	Sv
/DOS	投与量	S DOS>0.8	mg/kg
/DV	動的粘度	S DV>5000	Pa s
/ECH	電荷	S 10-15/ECH.EX (XA) CAPACITOR	C
/ECD	電荷密度	S 1-20/ECD.EX (XA) ELECTRICAL	C/m ²
/ECO	電気伝導率	S ECO>1000 (XA) WIRE	S/m
/ELC	電流	S 1-10/ELC	A
/ELF	電場	S 1-5/ELF	V/m
/ENE	エネルギー	S L1 AND 10000/ENE	J
/ERE	電気抵抗率	S ERE>10 (P) ISOLAT?	Ω m
/FOR	力	S 50 N/FOR	N
/FRE	周波数	S ANALY?/CLM (10A) 0-3/FRE	Hz
/IU	国際単位	S IU>1000 (P) ANTIBIOTIC	IU
/KV	動粘性率	S LUBRICANT/BI (S) 10E-5/KV	m ² /s
/LEN	長さ	S 1-4/LEN	m
または /SIZ			
/LUME	照度	S 10-50/LUME	lx
/LUMF	光束	S L74 (S) LUMF>70	lm
/LUMI	光度	S 5<LUMI<15	cd
/M	質量	S ALLOY/BI (30A) 1E-10-1E-5/M	kg
/MCH	質量電荷比	S MCH=3	m/z
/MFD	磁束密度	S MFD.EX>0E-3 (S) MAGNETIC RESONANCE	T
または /MFS			
/MFR	質量流量	S MFR.EX<0E-3	kg/s
または /MFL			
/MM	モル質量, 分子量	S 2000-3000 G/MOL/MM	g/mol
/MOLS	質量モル濃度	S 0.1-10 mol/kg/MOLS	mol/kg
/MVR	メルトフローレート	S 5-10/MVR	g/10min
/NUC	栄養素含量	S NUC<100 (XW) NUTRIENT	g/100kcal
/PER	パーセント	S (TITAN? (3A) DIOXID?)/CLM (S) 5/PER	%
/PERA	誘電率	S 1-10/PERA (S) BUFFER	F/m
/PHV	水素イオン指数	S 7.4-7.6/PHV	pH

(続く)

- 1) PHP フィールドを EXPAND すると検索可能な物性値がわかります。
- 2) 物性値は専用の表示フィールドでは表示されませんが、全文フィールド (TI, AB, CLM) 中のヒットタームとしてハイライトされます。
- 3) 指数を用いて検索できます。例 : 18,000 は 1.8E+4 あるいは 1.8E4, 0.92 は 9.2E-1
- 4) SEARCH コードに .EX をつけて検索すると、特定の数値, または最大値と最小値が特定された数値範囲のみがヒットします。例 : => S 100-200/TEMP.EX
- 5) 単位を省略して検索すると、デフォルト単位での検索となります。

物性検索フィールド 1), 2), 3) 4) 5) (続き)

SEARCH コード	物性	SEARCH 例	デフォルト 単位 ⁵⁾
/POW	電力	S (SOLAR? OR PHOTOVOLTAIC?)/BI (10A) 5-10/POW	W
/PRES または /P	圧力	S (VACUUM (5A) DISTILL?)/BI (S) 1000-1100/PRES	Pa
/RAD	放射能	S RADI?/BI (P) 10-100/RAD	Bq
/RES	電気抵抗	S CERAMIC/CLM (P) 1-8/RES	Ω
/RSP	回転速度	S 7000-8000/RSP AND ENGINE	rpm
/SAR	面積	S (COATING? OR FOIL?)/BI (S) 10-100/SAR	m ²
/SOL	溶解度	S SOL>20 (10W) WATER	g/100g
/STSC	表面張力, ばね定数	S 60 J/M**2/STSC	J/m ²
/TCO	熱伝導率	S 30-40/TCO (S) THERMO?	W/m K
/TEMP または /T	温度	S (REACTION? (25A) PHOSPHAT?) (S) 10/TEMP S 10/TEMP	K
/TIM	時間	S ?INCUB?/CLM (10W) 10-50/TIM	s
/VEL または /V	速度	S PUMP?/BI (S) 1E-3-5E-3/VEL	m/s
/VELA	角速度	S ANG?/CLM (S) VELA>10	rad/s
/VLR	体積流量	S 2-5/VLR (XA) TUBE	m ³ /s
/VOL	体積	S ?FUSION?/BI (15A) 1E-8-2E- 8/VOL	m ³
/VOLT	電圧	S CALIBRAT?/BI (10A) 5E- 3<VOLT<7E-3	V

- 1) PHP フィールドを EXPAND すると検索可能な物性値がわかります。
- 2) 物性値は専用の表示フィールドでは表示されませんが、全文フィールド (TI, AB, CLM) 中のヒットタームとしてハイライトされます。
- 3) 指数を用いて検索できます。例 : 18,000 は 1.8E+4 あるいは 1.8E4, 0.92 は 9.2E-1
- 4) SEARCH コードに .EX をつけて検索すると、特定の数値, または最大値と最小値が特定された数値範囲のみがヒットします。例 : => S 100-200/TEMP.EX
- 5) 単位を省略して検索すると、デフォルト単位での検索となります。

ダウエント化合物番号 (/DCN) シソーラスの関係コード

ダウエント化合物番号 (/DCN) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (SELF, USE, UF)	E R09609+ALL/DCN
UF	非優先語 (SELF, UF)	E R22401+UF/DCN
USE	優先語 (SELF, USE)	E ACETIC ACID+USE/DCN

ダウエント登録番号 (/DRN) シソーラス

ダウエント登録番号 (/DRN) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (SELF, USE, UF)	E 0495+ALL/DRN
UF	非優先語 (SELF, UF)	E 1314+UF/DRN
USE	優先語 (SELF, USE)	E ACETIC ACID+USE/DRN

ポリマー索引 (/PLE) シソーラス

新ポリマー索引 (/PLE) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語	E Q8457+ALL/PLE
	(BT, SELF, NOTE, USE, SEE, UF, NT, RT)	E CANS <APPLICATIONS> +ALL/PLE
AUTO ¹⁾	自動関係語 (SELF, USE, UF)	E BACTERICIDE <ADDITIVES> +AUTO/PLE
BT	上位語 (BT, SELF)	E Q8457+BT/PLE
HIE	階層語 (BT, SELF, NT)	E Q8399+HIE/PLE
KT	キーワードターム (指定したキーワードを含むフレーズ) (SELF, KT)	E CANS+KT/PLE E POLYOL+KT/PLE
NT	下位語 (SELF, NT)	E Q8366+NT/PLE
RT	関連語 (SELF, RT)	E Q7034+RT/PLE
UF	非優先語 (SELF, UF)	E DIELECTRIC CONSTANT+UF/PLE
USE	優先語 (SELF, USE)	E BIOCIDES <ADDITIVES> +USE/PLE

1) SET REL ON の状態で関係コードを付けずに EXPAND または SEARCH した場合は、関係コードを AUTOとした結果と同じになります(デフォルトは SET REL OFF)。

プラスドックキーシリアル (/KS) シソーラス

プラスドックキーシリアル (/KS) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (CODE, DEF)	E GASEOUS+ALL/KS

■ マニュアルコード (/MC) シソーラス

マニュアルコード (/MC) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (BT, DEF, HNTE, SELF, NT, RT)	E A03-A04A1+ALL/MC
AUTO ¹⁾	自動関係語 (SELF, HNTE, DEF)	E S01-B05+AUTO/MC
BT	上位語 (BT, SELF)	E S06-B02A+BT/MC
NT	下位語 (NT, SELF)	E S06-B02+NT/MC

1) SET REL ON の状態で関係コードを付けずに EXPAND または SEARCH した場合は、関係コードを AUTO とした結果と同じになります (デフォルトは SET REL OFF)。

■ 特許出願人コード (/PACO) シソーラス

特許出願人コードシソーラスは、1907 年以降の頻出度の高い主な会社名を /PACO フィールドで確認できる機能です。

特許出願人コードを EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL (CODE)	会社名に関連するすべての特許出願人コード (SELF, CODE)	E BAYER+ALL/PACO
DEF	コードに対応するすべての会社名 (SELF, DEF)	E FARB-C+DEF/PACO

■ タイトルターム (/TT) シソーラス

タイトルターム (/TT) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (SELF, USE, UF)	E ABLATION+ALL/TT
AUTO ¹⁾	自動関係語 (SELF, USE)	E FABRICATIONS+AUTO/TT
UF	非優先語 (SELF, UF)	E FABRICATE+UF/TT
USE	優先語 (SELF, USE)	E FABRICATED+USE/TT

1) SET REL ON の状態で関係コードを付けずに EXPAND または SEARCH した場合は、関係コードを AUTO とした結果と同じになります (デフォルトは SET REL OFF)。

国際特許分類（IPC）のシソーラス

国際特許分類第 8 版の分類を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。
国際特許分類シソーラスは 1967 年以降のレコードに対応しています。

関係コード	内 容	入 力 例
ADV	対応するアドバンスレベルの IPC コード	E A61K0006-02+ADV/IPC
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, NT, RT)	E C01C0003-00+ALL/IPC
BRO (MAN)	すべてのクラス	E C01C+BRO/IPC
BT	上位語 (BT, SELF)	E C01F0001-00+BT/IPC
CORE (COR)	対応するコアレベルの IPC コード	E C03B0001-02+COR/IPC
ED	入力した IPC の完全名と版	E C01F0001-00+ED/IPC
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E C01F0011-36+HIE/IC
INDEX	入力した IPC の完全名	E C01F0001-00+INDEX/IPC
KT	入力語に関する IPC コード (キャッチワード) (SELF, KT)	E CYANOGEN+KT/IPC
NEXTn	次の IPC コード (n は無しまたは数字)	E C01C0001-00+NEXT5/IPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E C01C+NT/IPC
PREVn	前の IPC コード (n は無しまたは数字)	E C01C0001-12+PREV3/IPC
RT (SIB)	関連語 (同じ階層の分類) (SELF, RT)	E C01C0003-20+RT/IPC
TI	入力した IPC と上位の完全名とコード (BT, SELF)	E C01F0001-00+TI/IPC

旧版 (第 1 版～第 7 版) のシソーラスを EXPAND または SEARCH する場合は、/IPC に続けて各版の番号を入力します。(例 ; /IPC7)

共通特許分類 (/CPC), ヨーロッパ特許分類 (/EPC, /ICO) のシソーラス

共通特許分類 (/CPC), ヨーロッパ特許分類 (/EPC, /ICO) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語, 簡略表示 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E C12M0001-3446+ALL/CPC
AUTO ¹⁾	自動関係語 (BT, SELF, CODE, DEF)	E G01J0003-443+AUTO/CPC
BT	上位語 (BT, SELF)	E G01J0003-443+BT/CPC
CODE	分類コード (SELF, CODE)	E SCRAPER BIASING MEANS+CODE/CPC
DEF	定義 (SELF, DEF)	E B65G0045-16+DEF/CPC
HIE	階層関係語 (上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E A01B0001+HIE/CPC
KT	キーワードターム (キャッチワード) (SELF, KT)	E LASER+KT/CPC
MAX	すべての関係語 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E G01J0003-447+MAX/CPC
NEXT	次の分類	E A01B0001-24+NEXT/CPC
NEXTn	次の n 個の分類	E A01B0001-24+NEXT3/CPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E G05B0001-04+NT/CPC
PREV	前の分類	E A61B0001-32+PREV/CPC
PREVn	前の n 個の分類	E G05B0019-418+PREV2/CPC
TI	入力語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E G05B0001-03+TI/CPC

1) 自動関係のデフォルトは OFF になっています。SET RELATION ON に設定すると、関係コードを付けずに EXPAND した結果は関係コードを AUTO としたときと同じになります。

■ 米国特許分類 (/NCL) のシソーラス

米国特許分類 (/NCL) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, DEF, NT)	E 257E21685+ALL/NCL
AUTO ¹⁾	自動関係コード (BT, SELF, DEF, NT)	E 02416300R+AUTO/NCL
BT	上位語 (BT, SELF)	E 02416300R+BT/NCL
CODE	分類コード (SELF, CODE)	E APPAREL+CODE/NCL
DEF	定義 (SELF, DEF, DEF2, DEF3, DEF4)	E G9B031001+DEF/NCL
HIE	階層語 (BT, SELF, DEF, NT)	E 235487000+HIE/NCL
KT	キーワードターム (SELF, KT)	E APPAREL+KT/NCL
MAX	すべての関係語 (BT, SELF, DEF, DEF2, DEF3, DEF4 NT, KT)	E G9B031000+MAX/NCL
NEXT	次の分類	E G9B033035+NEXT/NCL
NEXTn	次の n 個の分類	E G9B033035+NEXT2/NCL
NT	下位語 (SELF, NT)	S 257E21685+NT/NCL
PREV	前の分類	E 235462260+PREV/NCL
PREVn	前の n 個の分類	E 235462260+PREV3/NCL
TI	入力した語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E 052002110+TI/NCL

1) 自動関係のデフォルトは OFF になっています。SET RELATION ON に設定すると、関係コードを付けずに EXPAND した結果は関係コードを AUTO としたときと同じになります。

■ F ターム (/FTERM) のシソーラス

日本特許庁により付与される特許分類である F ターム (/FTERM) のシソーラスが利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, NT)	E 2B002/AA05+ALL/FTERM
BT	上位語 (SELF, BT)	E 2B002/AA05+BT/FTERM
CODE	シソーラステキスト語のコード	E PLYWOODS+CODE/FTERM
DEF	定義	E 2B002/BA13+DEF/FTERM
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語)	E 2B002/AA05+HIE/FTERM
KT	キーワードターム	E PLYWOODS+KT/FTERM
NT	下位語	E 2B002+NT/FTERM
RFI	関連 FI 分類ターム	E 2B001+RFI/FTERM
TI	入力語および上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E 2B002/AA09+TI/FTERM

■ FI (/FCL) のシソーラス

日本特許庁により付与される特許分類である FI (/FCL) のシソーラスが利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語	E A23B0004-00+ALL/FCL
MAX	すべての関連語 (BT, SELF, NT, RT, DEF)	E A23B0004-00+MAX/FCL
BT	上位語 (SELF, BT)	E A23B0004-00+BT/FCL
DEF	定義	E A23B0004-00+DEF/FCL
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語)	E A23B0004-00+HIE/FCL
INDX	インデックスノート	E C01F0001-00+INDX/FCL
NOTE	スコープノート	E F24F+NOTE/FCL
NT	下位語	E A23B0004-00+NT/FCL
RT	関連語	E F24F+RT/FCL
TI	入力語および上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E A23B0004-00+TI/FCL

表示形式

回答の表示をする際は、下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。

複数のコードはスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。

入力例 ; => D L1 1-5 BIB ABS

=> D L1 TI, AU, SO, CS, AB

カスタム表示形式

表示形式	英語名	内容	入力例
AB	Abstract (Basic)	抄録 (Basic 特許, UPAB を含む)	D TI PA AB
ABDT *	Abstract, Documentation Type	ドキュメンテーション抄録	D ABDT
ABEQ	Abstract, Equivalent	対応特許抄録	D ABEQ
ABEX *	Abstract, Extended	拡張抄録 (UPTX を含む)	D ABEX
ACTN	Mechanism of Action	Mechanism of Action	D ACTN
ACTV	Activity	Activity	D ACTV
ADT ¹⁾	Application Details	出願情報の詳細	D ADT
ADT.B ^{1), 2)}	Application Details, Basic	出願情報の詳細, Basic 特許	D 1-5 ADT. B
ADV	Advantage	Advantage	D ADV
AI (AP) ¹⁾	Application Information	出願情報	D AI PI
AI.B ¹⁾	Application Information, Basic	出願情報, Basic 特許	D AI. B
ALE	Alerting Abstract, First Section	抄録の第一セクション	D ALE
AN	Accession Number	レコード番号	D AN
ANX	Alternative Accession Number	追加レコード番号	D ANX
AW	Additional Words	追加語	D AW
CC	Classification Code (Substance Descriptor)	分類コード	D CC
CMC	Chemical Code	ケミカルコード	D CMC
CPC	Cooperative Patent Classification	共通特許分類	D CPC
CR (XR)	Cross Reference	クロスリファレンス	D AN CR
CYC	Country Count	特許発行国数	D CYC
DC	DWPI Class	ダウエントクラス	D DC
DCN	DWPI Compound Number	ダウエント化合物番号	D DCN
DN	Document Number (DNC and DNN)	第二次アクセッション番号	D DN
DNC	Document Number CPI	第二次アクセッション番号 CPI	DISPLAY DNC
DNN	Document Number Non CPI	第二次アクセッション番号 CPI 以外	D DNN
DRN	DWPI Registry Number	ダウエント登録番号	D DRN
DRWN	Number of Drawings	図面の数	D DRWN
DS ²⁾	Designated State	指定国	D DS
DUPD ²⁾	DWPI Update	Clarivate Analytics アップデート	D DUPD
ED	Entry Date	入力日	D ED
EPC (ECLA, EPCLA)	European Patent Classification	ヨーロッパ特許分類	D EPC
FA	Field Availability	フィールドの存在	D FA
FCL (JPC)	Japanese Patent Classification (FI or File Index)	FI	D FCL
FDT ¹⁾	Filing Details	出願経過の詳細	D FDT
FG (AM)	Fragment Code	フラグメンテーションコード	D FG
FS	File Segment	ファイルセグメント	D FS
FTRM (FTERM, FTCLA, JPCLA)	Japanese Patent Classification (FTERM or File Forming Term)	F ターム	D FTRM

(続く)

* WPIX ファイルでのみ利用可能です。

- 1) 出願番号, 優先権出願番号, 特許番号, 国際特許分類は, ダウエント形式と STN 形式の両方で表示できます。DISPLAY, PRINT, SELECT, ANALYZE および SORT のための形式は, SET PATENT コマンドで変更可能で, STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには, => SET PAT DERWENT (PERM) と入力します。STN 形式に戻す場合は => SET PAT STN と入力します。
- 2) カスタム形式のみの表示です。

カスタム表示形式 (続き)

表示形式	英語名	内容	入力例
GI(GI.H) ^{3),4)}	Graphic Information	図面情報	D GI
GINF(GIS)	Graphic Image(s) Information	図面関連情報	D GINF
IC ¹⁾	International Patent Classification (includes ICM and ICS)	国際特許分類 (主分類・副分類を含む)	D TI PA IC
ICA ¹⁾	IPC, Additional (Supplementary)	国際特許分類, 追加分類 (参考情報)	DISPLAY ICA
ICI ¹⁾	IPC, Index (Complementary)	国際特許分類, インデキシング コード (相補情報)	D ICI
ICM ¹⁾	IPC, Main	国際特許分類, 主分類	D ICM
ICO	Index Codes (EPO)	コンピュータ分類 (EPO)	D ICO
ICS ¹⁾	IPC, Secondary	国際特許分類, 副分類	D ICS
IN (AU)	Inventor	発明者名	D IN
IPCI ¹⁾	IPC, Initial	国際特許分類, 発行時	D IPCI
IPCR ¹⁾	IPC, Reclassified	国際特許分類, 再分類	D IPCR
IT (KW)	Index Term (incl. DCR numbers)	索引 (DCR 番号を含む)	D IT D KW
KS	Plasdoc Key Serials	プラスドックキーシリアル番号	D KS
M0-M6	Chemical Codes	ケミカルコード	D M1
MC	Manual Code	マニュアルコード	D MC
NCL	US National Patent Classification, Current	米国特許分類 (現行)	D NCL
NOV	Novelty	Novelty	D NOV
PA (CS)	Patent Assignee (incl. code)	特許出願人 (コードを含む)	D IN PA PI
PI ^{1),5)}	Patent Information	特許情報	D PI
PI.B (PN.B) ^{1),5)}	Patent Information Basic	特許情報, Basic 特許	D PI.B
PIA ¹⁾	Patent Information Abbreviated	特許情報省略形	D PIA
PIA.B ¹⁾	Patent Information Abbreviated, Basic	特許情報省略形, Basic 特許	D PIA.B
PN ^{1),5)}	Patent Number	特許番号 (PI の指定国情報を除 いたもの)	D PN
PNC	Patent Number Count	特許番号数	D PNC
PNK	Patent Number/Kind code	種別付き特許番号	D PNK
PNK.B	Patent Number/Kind code, Basic	種別付き特許番号, Basic 特許	D PNK.B
PLC	Polymer Coding Plasdoc	プラスドックポリマー索引	D PLC
PLE	Polymer Indexing Enhanced	新ポリマー索引 (UPA を含む)	D PLE
PRAI (PRN) ¹⁾	Priority Information	優先権情報	D PI PRAI
RIN	Ring Index Number	リングインデックス番号	D RIN
SL	Summary Language	抄録の言語	D SL
TECH	Technology Focus	Technology Focus (UPTX を含む)	D TECH
TI ⁶⁾	Title	標題	D TI
TT	Title Terms	タイトルターム	D TT
UADV	Use/Advantage Section	Use/Advantage	D UADV

(続く)

- 1) 出願番号, 優先権出願番号, 特許番号, 国際特許分類は, ダウエント形式と STN 形式の両方で表示できます. DISPLAY, PRINT, SELECT, ANALYZE および SORT のための形式は, SET PATENT コマンドで変更可能で, STN 形式がデフォルトです. ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには, => SET PAT DERWENT (PERM) と入力します. STN 形式に戻す場合は => SET PAT STN と入力します.
- 3) イメージ情報の表示には, STN Express などの CCITT の T6 グループ 4 の圧縮法を用いた TIFF イメージを扱える通信ソフトが必要です. または STN on the Web でもご利用いただけます.
- 4) イメージ情報の解像度は, 情報量により自動調整され, 情報量 4,999 バイトまで解像度 300dpi, 5,000-24,999 バイトで 150dpi, 25,000 バイト以上で 75dpi となります. .H 付きの表示形式で表示させた場合, 解像度は常時 300dpi となります.
- 5) パテントファミリー表示中では, ベーシック特許は "*" で, ベーシックとして扱われる対応特許は "B" で, パリ条約に基づいていない対応特許を "#" で識別します.
- 6) WPIDS/WPIX のみオンライン・ディスプレイ料金は無料です.

■ カスタム表示形式 (続き)

表示形式	英語名	内容	入力例
UP ²⁾	Update Date	更新日	D UP AN
UPA	Update Date Polymer Indexing	ポリマー索引の更新日	D UPA
UPAB	Update Date Abstract	抄録の更新日	D UPAB
UPB	Update Date Chemical Code	ケミカルコードの更新日	D UPB
UPDA ²⁾	Update Date Documentation Abstract	ドキュメンテーション抄録の更新日	D UPDA
UPEQ	Update Date Equivalent	対応特許の更新日	D UPEQ
UPGI	Update Date Graphic Image	図面イメージの更新日	D UPGI
UPIC	Update International Patent Classification code	国際特許分類の更新日	D UPIC
UPIN	Update Inventor	発明者の更新日	D UPIN
UPIT (UPKW)	Update Date Index Terms	索引の更新日	D UPIT
UPPA ²⁾	Update Date Patent Assignee	特許出願人の更新日	D UPPA
UPPI ²⁾	Update Date Patent Information	特許情報の更新日	D UPPI
UPPR ²⁾	Update Date Priority Information	優先権情報の更新日	D UPPR
UPS ²⁾	Update Date SDI	SDI 更新日	D UPS
UPTI ²⁾	Update Date Enhanced Title	標題の更新日	D UPTI
USE	Use Section	Use	D USE

2) カスタム形式のみの表示です。

■ 定型表示形式

表示形式	内容	入力例
ABS	抄録 AN, CR, AB, UPAB, ABEQ	D TI PA ABS
ALL ¹⁾	発明レベルのすべてのデータ (対応特許抄録, Technology Focus, ケミカルコード, ポリマー索引, ドキュメンテーション抄録*, 拡張抄録*を除く) AN, CR, ANX, DNN, DNC, TI, DC, IN, PA, CYC, PI, ADT, FDT, PRAI, IPC, CPC, EPC, ICO, NCL, FCL, FTRM, AB, UPAB, MC	D ALL
DALL ¹⁾	デリミタ型 ALL 形式	D DALL
IALL ¹⁾	フィールド名付きインデント型 ALL 形式	D IALL
ALLG	イメージ情報付き ALL	D ALLG
(ALLG. H) ^{1), 2), 3)}		
IALLG	フィールド名付きインデント型 ALLG 形式	D IALLG
(IALLG. H) ^{1), 2), 3)}		
ANL (無料)	レコード番号リスト (回答番号なし)	D ANL
APPS ¹⁾	ADT, PRAI	D APPS
BASIC ¹⁾	AN, CR, ANX, DNN, DNC, TI, DC, IN, PA, PNC, CYC, PI. B, ADT. B, PRAI, AB, UPAB, FS	D BASIC
BIB ¹⁾	書誌情報 AN, CR, DNN, DNC, TI, DC, IN, PA, CYC, PIA, ADT, FDT, PRAI	D BIB
IBIB ¹⁾	フィールド名付きインデント型 BIB 形式	D IBIB
BRIEF	書誌情報 (特許情報なし) AN, CR, ANX, DNN, DNC, TI, DC, PA, AB, UPAB	D BRIEF
IBRIEF	フィールド名付きインデント型 BRIEF 形式	D IBRIEF

(続く)

- 1) 出願番号, 優先権出願番号, 特許番号, 国際特許分類は, ダウエント形式と STN 形式の両方で表示できます。DISPLAY, PRINT, SELECT, ANALYZE および SORT のための形式は, SET PATENT コマンドで変更可能で, STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには, => SET PAT DERWENT (PERM) と入力します。STN 形式に戻す場合は => SET PAT STN と入力します。
- 2) イメージ情報の表示には, STN Express などの CCITT の T6 グループ 4 の圧縮法を用いた TIFF イメージを扱える通信ソフトが必要です。または STN on the Web でもご利用いただけます。
- 3) イメージ情報の解像度は, 情報量により自動調整され, 情報量 4,999 バイトまで解像度 300dpi, 5,000-24,999 バイトで 150dpi, 25,000 バイト以上で 75dpi となります。 .H 付きの表示形式で表示させた場合, 解像度は常時 300dpi となります。

網がけ はおすすめの定型表示形式です。

定型表示形式 (続き)

表示形式	内 容	入 力 例
BRIEFG (BRIEFG.H) ^{2),3)}	イメージ情報付き BRIEF	D BRIEFG
IBRIEFG (IBRIEFG.H) ^{2),3)}	フィールド名付きインデント型 BRIEFG 形式	D IBRIEFG
CODE (IND) (無料)	AN, DC, IPC, CPC, EPC, ICO, NCL, FCL, FTRM, MC, IT, DRN, PLE, CMC	D CODE
CPC.TAB (無料)	CPC, 表形式	D CPC.TAB
FAM ¹⁾	PI, ADT, FDT, PRAI	D FAM
FULL ¹⁾	発明レベルのすべてのデータ (対応特許抄録, ケミカルコード, ポリマー索引を除く. ただし Technology Focus, ドキュメンテー ション抄録*, 拡張抄録* は含む) AN, CR, ANX, DNN, DNC, TI, DC, IN, PA, CYC, PI, ADT, FDT, PRAI, IPC, CPC, EPC, ICO, NCL, FCL, FTRM, AB, UPAB, TECH, ABEX*, FS, MC, ABDT*	D FULL
IFULL ¹⁾	フィールド名付きインデント型 FULL 形式	D FULLG
FULLG (FULLG.H) ^{1),2),3)}	イメージ情報付き FULL	D IFULL
IFULLG (IFULLG.H) ^{1),2),3)}	フィールド名付きインデント型 FULLG 形式	D IFULLG
IPC (無料)	IC (ICM, ICS), ICA, ICI, IPCI, IPCR	D IPC
IPC.TAB (無料)	詳細な IPC 情報 (表形式)	D IPC.TAB
MAX ¹⁾	発明レベルのすべてのデータ (ケミカルコード, ポリマー索引, Technology Focus, ドキュメンテーション抄録*, 拡張抄録* を 含む) AN, ED, CR, ANX, DNC, DNN, TI, AW, DC, IN, PA, CYC, PI, ADT, FDT, PRAI, IPC, CPC, EPC, ICO, NCL, FCL, FTRM, AB, UPAB, TECH, ABEX*, ABDT*, IT, FS, MC, PLC, PLE, CMC, DRN	D MAX
IMAX ¹⁾	フィールド名付きインデント型 MAX 形式	D IMAX
MAXG (MAXG.H) ^{1),2),3)}	イメージ情報付き MAX	D MAXG
IMAXG (IMAXG.H) ^{1),2),3)}	フィールド名付きインデント型 MAXG 形式	D IMAXG
PATS ¹⁾	PI, FDT	D PATS
SCAN ⁴⁾ (無料)	回答チェック用の表示形式 (回答番号なしのランダム表示) AN (WPIDS/WPIX ファイルのみ), TI	D SCAN
STD ¹⁾ (デフォルト)	書誌情報, 特許分類 AN, CR, DNN, DNC, TI, DC, IN, PA, CYC, PI, ADT, FDT, PRAI, IPC	D STD CMC
ISTD ¹⁾	フィールド名付きインデント型 STD 形式	D ISTD
SUM	AN, TI, NOV	D SUM
TRIAL (無料) (TRI, SAMPLE)	回答チェック用の表示形式 AN, CR, ANX, DNN, DNC, TI (WPIDS/WPIXファイルのみ), TT (WPINDEX ファイルのみ), DC, IPC, CPC, EPC, ICO, MC	D TRI
UPP	PN と対応する特許番号入力日	D UPP
XMLDOC *	XML 形式での出力 (グラフィックを除く全データ)	D XMLDOC

* WPIX ファイルでのみ利用可能です。

- 1) 出願番号, 優先権出願番号, 特許番号, 国際特許分類は, ダウエント形式と STN 形式の両方で表示できます. DISPLAY, PRINT, SELECT, ANALYZE および SORT のための形式は, SET PATENT コマンドで変更可能で, STN 形式がデフォルトです. ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには, => SET PAT DERWENT (PERM) と入力します. STN 形式に戻す場合は => SET PAT STN と入力します.
- 2) イメージ情報の表示には, STN Express などの CCITT の T6 グループ 4 の圧縮法を用いた TIFF イメージを扱える通信ソフトが必要です. または STN on the Web でもご利用いただけます.
- 3) イメージ情報の解像度は, 情報量により自動調整され, 情報量 4,999 バイトまで解像度 300dpi, 5,000-24,999 バイトで 150dpi, 25,000 バイト以上で 75dpi となります. .H 付きの表示形式で表示させた場合, 解像度は常時 300dpi となります.
- 4) SCAN はコマンドに続けて入力します. 例:D SCAN または DISPLAY SCAN

網がけ はおすすめの定型表示形式です。

■ ヒットタームに関する表示形式

多くのフィールドでヒットタームハイライト機能が利用できます。(検索時にハイライト機能が ON になっていることが必要です)

表示形式	内 容	入 力 例
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D HIT
HITCMC (無料)	ヒットしたケミカルコード	D HITCMC
HITCODE (無料)	ヒットタームを含む CMC, EPC, FCL, FTRM, ICO, IPC, MC, NCL, PLC, PLE, CPC	D HITCODE
HITMEMB	ヒットタームを含む公報レベルのフィールド	D HITMEMB
HITPLC (無料)	ヒットしたプラスドックポリマー索引	D HITPLC
HITPLE (無料)	ヒットした新ポリマー索引	D HITPLE
HITSTR ¹⁾ (無料)	ヒットした DCR セグメントのレコード	D HITSTR
FRAGHITSTR (無料)	ヒットしたフラグメンテーションコードに対応する DCR セグメントのレコード	D FRAGHITSTR
KWIC ²⁾	ヒットタームの前後 20 語を表示 (KeyWord-In-Context)	D KWIC
OCC (無料)	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D OCC

1) DCR セグメントから DWPI セグメントへクロスオーバー検索した回答に利用

2) ヒットタームが、無料の表示形式のフィールドにのみ含まれる場合は、表示料金は無料です。

■ カスタム表示形式 (公報レベル)

表示形式	英語名	内容	入力例
ABDE	Abstract, Original, in German	抄録, オリジナル (ドイツ語)	D ABDE
ABEN	Abstract, Original, in English	抄録, オリジナル (英語)	D ABEN
ABES	Abstract, Original, in Spanish	抄録, オリジナル (スペイン語)	D ABES
ABFR	Abstract, Original, in French	抄録, オリジナル (フランス語)	D ABFR
ABOL	Abstract, Original, other languages	抄録, オリジナル (その他の言語)	D ABOL
AG	Agent	代理人	D AG
AG.T	Agent, Total	代理人 (全フィールド)	D AG.T
AGA	Agent Address	代理人住所	D AGA
AN.PUB	Accession Number, Publication Level	レコード番号, 公報レベル	D AN.PUB
APTS	Application Information, Clarivate Analytics	出願情報 (Clarivate Analytics)	D APTS
CLM	Claims (CLMEN, CLMDE, CLMFR)	クレーム	D CLM
CLMDE ¹⁾	Claims, German Language	クレーム (ドイツ語)	D CLMDE
CLMEN ¹⁾	Claims, English Language	クレーム (英語)	D CLMEN
CLMFR ¹⁾	Claims, French Language	クレーム (フランス語)	D CLMFR
CPC.TAB.M ²⁾	CPC, Tabular Display, Member	共通特許分類, 表形式 (公報レベル)	D CPC.TAB.M
FS.M	File Segment (Individual Patent Publication Section)	ファイルセグメント (公報レベル)	D FS.M
GI.M	Graphic Information, Member Patent	図面イメージ, 公報レベル	D GI.M
IIC ²⁾	Initial International Patent Classification (ICM, ICS)	国際特許分類, 発行時 (主分類, 副分類)	D IIC
IICA ²⁾	Initial IPC, Additional (supplementary)	国際特許分類, 発行時 追加分類 (参考情報)	D IICA
IICI ²⁾	Initial IPC, Index (complementary)	国際特許分類, 発行時 インデキシングコード (相補情報記号)	D IICI
IICM ²⁾	Initial IPC, Main	国際特許分類, 発行時 主分類	D IICM
IICS ²⁾	Initial IPC, Secondary	国際特許分類, 発行時 副分類	D IICS
IN.T	Inventor, Total	発明者 (全フィールド)	D IN.T
INA	Inventor Address	発明者のアドレス	D INA
INCL	National Classification, Issued	米国特許分類, 発行時	D INCL
INO	Inventor, Original	発明者, オリジナル	D INO
IPC.TAB.M ²⁾	IPC, Tabular Display, Member	国際特許分類, 表形式 (公報レベル)	D IPC.TAB.M
MCLM (CLM)	Main Claim	メインクレーム	D MCLM
PA.T	Patent Assignee, Total	特許出願人 (全フィールド)	D PA.T
PAA	Patent Assignee Address	特許出願人住所	D PAA
PAO	Patent Assignee, Original	特許出願人, オリジナル	D PAO
PRTS	Priority Application Information, Clarivate Analytics	優先権出願情報 (Clarivate Analytics)	D PRTS
TIDE ³⁾	Title, Original, in German	原標題 (ドイツ語)	D TIDE
TIEN ³⁾	Title, Original, in English	原標題 (英語)	D TIEN
TIES ³⁾	Title, Original, in Spanish	原標題 (スペイン語)	D TIES
TIFR ³⁾	Title, Original, in French	原標題 (フランス語)	D TIFR

* WPIX ファイルでのみ利用可能です。

1) カスタム形式のみの表示です。

2) 出願番号, 優先権出願番号, 特許番号, 国際特許分類は, ダウエント形式と STN 形式の両方で表示できます。DISPLAY, PRINT, SELECT, ANALYZE および SORT のための形式は, SET PATENT コマンドで変更可能で, STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには, SET PAT DERWENT (PERM) と入力します。STN 形式に戻す場合は SET PAT STN と入力します。

3) WPIDS/WPIX のみオンライン・ディスプレイ料金は無料です。

■ 定型表示形式（公報レベル）

表示形式	内 容	入 力 例
MEMB ¹⁾	レコードに含まれるすべての公報レベルの以下の情報 (著者抄録, クレームを含む以下のフィールド) PI, TIEN, TIDE, TIFR, TIES, AG, IN, INO, INA, PA, PAO, PAA, ADT, APTS, FDT, PRAI, PRTS, IPC, IIC, IICI, IICA, CPC.M, EPC.M, ICO.M, NCL.M, INCL, FCL, FTRM, ABEN, ABDE, ABFR, CLM, DRN	D ALL MEMB
MEMBG ^{1),2)}	イメージ情報付き MEMB	D MEMBG
MEMB(n) ¹⁾	特定の公報レベル番号の MEMB (n = 1, 2, 3 . . .)	D MEMB(1)
MEMBB	レコードに含まれるすべての公報レベルの以下の情報 (著者抄 録, クレームを含む以下のフィールド) PN, TI, TIEN, TIDE, TIFR, TIES, AG.T, IN.T, PA.T, ABEN, ABDE, ABFR, CLMEN, CLMDE, CLMFR	D MEMBB
MEMBF ¹⁾	レコードに含まれるすべての公報レベルの以下の情報 AN, ED, CR, ANX, DNC, DNN, TI, TIEN, TIDE, TIFR, TIES, AW, DC, AG, IN, INO, INA, PA, PAO, PAA, CYC, PI, ADT, APTS, FDT, PRAI, PRTS, IPC, IIC, IICI, IICA, CPC.M, EPC.M, ICO.M, NCL.M, INCL, FCL, FTRM, AB, ABEQ, TECH, ABEX*, ABDT*, ABDE, ABEN, ABFR, CLMEN, CLMDE, CLMFR, IT, FS.M, MC, DRN	D MEMBF
MEMBFG ^{1),2)}	イメージ情報付き MEMBF	D MEMGFG
MEMBF(n) ¹⁾	特定の公報レベル番号の MEMBF (n = 1, 2, 3 . . .)	D MEMBF(3)

* WPIX ファイルでのみ利用可能です。

- 1) 出願番号, 優先権出願番号, 特許番号, 国際特許分類は, ダウエント形式と STN 形式の両方で表示できます。DISPLAY, PRINT, SELECT, ANALYZE および SORT のための形式は, SET PATENT コマンドで変更可能で, STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには, SET PAT DERWENT (PERM) と入力します。STN 形式に戻す場合は SET PAT STN と入力します。
- 2) イメージ情報の表示には, STN Express などの CCITT の T6 グループ 4 の圧縮法を用いた TIFF イメージを扱える通信ソフトが必要です。または STN on the Web でもご利用いただけます。

網がけ はおすすめの定型表示形式です。

■ カスタム表示形式 (DCR セグメント)

表示形式	英語名	内容	入力例
AN.S	DERWENT Chemistry Resource Accession Number, DCR Segment	DCR レコード番号, DCR セグメント	D AN.S
CC	Classification Code (Substance Descriptor)	分類コード (物質ディスクリプタ)	D CC
CMT	Comment	注記	D CMT
CN.P	Chemical Name, Preferred	化学物質名, 優先	D CN.P 2,4
CN.S	Chemical Name, Systematic	化学物質名, 統制	D CN.S
CT	Controlled Term	DDF 統制語	D CT
DCSE	DERWENT Chemistry Resource Number, DCR Segment	DCR 番号, DCR セグメント	D DCSE
DDRN	Derwent Drug Registry Name	ダウエントドラッグ登録名	D DDRN
EDCR	Entry Date Chemistry Resource	DCR 入力日	D EDCR
MF	Molecular Formula	分子式	D MF MW 1-5
MW	Molecular Weight	分子量	D MW
SCR	Structure Cross Reference	構造クロスリファレンス	D SCR
SDCN	Structure Segment DERWENT Compound Number	ダウエント化合物番号, DCR セグメント	D SDCN
SDRN	Structure Segment DERWENT Registry Number	ダウエント登録番号, DCR セグメント	D SDRN
SMF	Standardized Molecular Formula	標準化された分子式	D SMF
SRIN	Structure Segment Ring Index Number	リングインデックス番号, DCR セグメント	D SRIN
SS	Structure Terms	部分構造用語	D SS
STR	Chemical Structure Display	化学構造図	D STR
SY	Synonym Name	同義名	D SY
UPCR	Update Date DWPI Chemistry Resource	DCR 更新日	D UPCR
UPWX	Update Date DWPI Cross Reference	WPI クロスリファレンス更新日	D UPWX

■ 定型表示形式 (DCR セグメント)

表示形式	内容	入力例
ALL (FULL)	AN.S, DSCE, CN.P, CN.S, SY, STR, CMT, MF, SMF, MW, SRIN, SDCN, SDRN, CC	D ALL
IALL (IFULL)	フィールド名付きインデント型 ALL 形式	D IALL
ALLSTR	書誌情報に含まれるすべての構造図	D ALLSTR
CN	CN.P, SY	D CN
MAX	AN.S, DSCE, CN.P, CN.S, SCR, SY, STR, CMT, MF, SMF, MW, SRIN, SDCN, SDRN, DDRN, CC, CT, SS, MPC	D MAX
IMAX	フィールド名付きインデント型 MAX 形式	D IMAX
SCAN ¹⁾ (無料)	CN.P, CN.S, MF, STR (回答番号なしのランダム表示)	D SCAN
STD (IDE)	AN.S, DCSE, CN.P, CN.S, SCR, SY, STR, CMT, MF (デフォルトは STD)	D STD
ISTD	フィールド名付きインデント型 STD 形式	D ISTD
TRIAL (無料) (TRI, SAMPLE)	CN.P, CN.S, MF, STR	D TRIAL

1) SCAN はコマンドに続けて入力します。例:D SCAN または DISPLAY SCAN

■ ヒットタームに関する表示形式 (DCR セグメント)

表示形式	内容	入力例
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D HIT
KWIC	ヒットタームの前後 20 語を表示 (KeyWord-In-Context)	D KWIC
OCC (無料)	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D OCC

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド

SELECT/ANALYZE コマンドは抽出・解析用のコマンドです。

入力例 ; => SEL L1 RN (回答セット L1 の回答全件から CAS 登録番号を抽出する)

=> ANA L1 1- PN (回答セット L1 の回答全件から特許番号を抽出する)

SORT コマンドは指定したフィールドのアルファベット順または数値順に検索結果を並び替えるコマンドです。入力例 ; => SORT L1 PD (回答セット L1 の回答全件を発行日の古い順に並び替える)

○は SELECT/ANALYZE/SORT 可能なコード, × は不可能なコードです。

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
AB	抄録 (Basic 特許)	○	×
ABDT	ドキュメンテーション抄録	○	×
ABEX	拡張抄録	○	×
AC	出願国	○	×
ACTN	Mechanism of Action	○	○
ACTV	Activity	○	○
AD	出願日	○	×
ADV	Advantage	○	○
ALE	抄録の第一セクション	○	○
AN	レコード番号	○	○
ANX	追加レコード番号	○	×
AP (AI, ADT)	出願番号	○ ²⁾	○
AP.YR	出願番号, 年	○	×
APPS	出願番号グループ	○ ³⁾	×
AW	追加語	○ ⁴⁾	×
AY	出願年	○	×
CR (XR)	クロスリファレンス	○	×
CPC	共通特許分類	○	×
CYC	特許発行国数	○	○
DC	ダウエントクラス	○	○
DCN	ダウエント化合物番号	○	×
DCR	DCR 番号	○	×
DCR.WR	DCR レコード番号	○	×
DCR.WRS	検索フィールド (/AN.S) 付 DCR レコード番号	○	×
DN	第二次アクセス番号	○ ⁵⁾	×
DNC	第二次アクセス番号 CPI	○	○
DNN	第二次アクセス番号 CPI 以外	○	○
DRN	ダウエント登録番号	○	×
DRWN	図面の数	○	○
DS	指定国	○	×
DUPD	Clarivate Analytics アップデート	○	○
DW	ダウエントウィーク	○ ⁶⁾	○
DW.B	ダウエントウィーク, Basic 特許	○ ⁶⁾	○
ED	入力日	○	○
EPC (ECLA, EPCLA)	ヨーロッパ特許分類	○	×
FACL	FI (追加分類)	○	×
FCL (JPC)	FI	○	×

(続く)

- 1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには, HIT を使います (例 : => SEL HIT TI)
- 2) 出願番号, 優先権番号, および特許番号は, SET PATENT コマンドで設定されている形式 (ダウエント形式または STN 形式) で SELECT, ANALYZE および SORT されます。
- 3) 出願番号および優先権番号が抽出され, SELECT で抽出されたタームに /APPS が付与されます。
- 4) SELECT で抽出されたタームに /TT が付与されます。
- 5) DNC と DNN が抽出され, SELECT で抽出されたタームに /DN が付与されます。
- 6) このフィールドでは SELECT HIT および ANALYZE HIT は使えません。

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
FDT	出願経過の詳細	○	×
FDT. PC (RLPC)	出願経過の詳細, 特許発行国	○	×
FDT. PK (RLPK)	出願経過の詳細, 特許種別コード	○	×
FDT. PN (RLPN)	出願経過の詳細, 特許番号	○	×
FDT. TP	出願経過の詳細, 出願タイプ	○	×
FG (AM)	フラグメンテーションコード	○	○
FICL	FI (インデキシング)	○	×
FS	ファイルセグメント	○	○
FMCL	FI (主分類)	○	○
FSCL	FI (副分類)	○	×
FTRM (FTERM, FTCLA, JPCLA)	F ターム	○	×
GINF (GIS)	図面サイズ情報	○	×
IC	国際特許分類, 主分類, 副分類	○	×
ICA	国際特許分類, コアレベル, 追加分類 (参考情報)	○	×
ICI	国際特許分類, インデキシングコード, (相補記号情報)	○	×
ICM	国際特許分類, 主分類	○	○
ICO	コンピュータ分類 (EPO)	○	×
ICS	国際特許分類, 副分類	○	×
IN (AU)	発明者	○	○
IPC	国際特許分類 (ICM, ICS, ICA, ICI, IPCI, IPCR)	○ ⁷⁾	×
IPC. A	国際特許分類, アドバンストレベル	○ ⁸⁾	×
IPC. AI	国際特許分類, アドバンストレベル, 発明レベル	○ ⁸⁾	×
IPC. C	国際特許分類, コアレベル	○ ⁸⁾	×
IPC. CI	国際特許分類, コアレベル, 発明レベル	○ ⁸⁾	×
IPC. F	国際特許分類, Main or First	○	○
IPC. REF	国際特許分類, リフォーム	○	×
IPCI	国際特許分類, 発行時	○ ⁸⁾	×
IPCR	国際特許分類, 再分類	○ ⁸⁾	×
IT (KW)	索引	○	×
KS	プラスドックキーシリアル番号	○	×
LA	出願言語	○ ⁶⁾	×
MO-M6	ケミカルコード	○	×
MC	マニュアルコード	○	×
MCN	マルクーシュ構造番号	○	×
NCL	米国特許分類	○	○
NCLM	米国特許分類, 主分類	○ ⁹⁾	×
NCLS	米国特許分類, 副分類	○ ⁹⁾	×
NOV	Novelty	○	○
OCC	ヒットタームの出現頻度	×	○
PA (CS)	特許出願人名	○	○
PACO	特許出願人コード	○	○
PATS	特許番号グループ	○ ^{2), 10)}	×

(続く)

- 1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには, HIT を使います (例 : => SEL HIT TI)
- 2) 出願番号, 優先権番号, および特許番号は, SET PATENT コマンドで設定されている形式 (ダウエント形式または STN 形式) で SELECT, ANALYZE および SORT されます.
- 6) このフィールドでは SELECT HIT および ANALYZE HIT は使えません.
- 7) IC, ICM, ICS, IPCI, IPCR が抽出され, SELECT で抽出されたタームに /IPC が付与されます.
- 8) 抽出されたタームに /IPC. REF が付与されます.
- 9) 抽出されたタームに /NCL が付与されます.
- 10) 特許番号と出願経過の詳細の特許番号 (FDT. PN) が抽出され, SELECT で抽出されたタームに /PATS が付与されます.

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
PAX	特許出願人名および特許出願人コード	○	○
PC	特許発行国	○	○
PC.B	特許発行国, Basic 特許	○	○
PCS	特許発行国グループ	○ ¹¹⁾	×
PD	特許発行日	○	○
PD.B	特許発行日, Basic 特許	○	○
PIA	特許情報省略形	○ ^{2), 12)}	○
PIA.B	特許情報省略形, Basic 特許	○ ^{2), 13)}	○
PK	特許種別コード	○	○
PK.B	特許種別コード, Basic 特許	○	○
PLE	新ポリマー索引	○	×
PN (PI)	特許番号	○ ²⁾	○
PN.B (PI.B)	特許番号, Basic 特許	○ ²⁾	○
PNC	特許番号数	○	○
PNK	種別付き特許番号	○	×
PNK.B	種別付き特許番号, Basic 特許	○	×
PRAI (PRN)	優先権情報	○ ^{2), 14)}	○
PRC	優先権主張国	○	×
PRD	優先権主張日	○	×
PRDF	最先の優先権主張日	○	○
PRY	優先権主張年	○	○
PRYF	最先の優先権主張年	○	○
PY	特許発行年	○	○
PY.B	特許発行年, Basic 特許	○	○
RIN	リングインデックス番号	○	×
SCG	サブクラスグループ	○ ¹⁵⁾	×
SCGA	サブクラスグループ, 追加分類	○ ¹⁶⁾	×
SCGM	サブクラスグループ, 主分類	○ ¹⁷⁾	×
SCGS	サブクラスグループ, 副分類	○ ¹⁸⁾	×
SCL	サブクラス	○ ¹⁵⁾	×
SCLA	サブクラス, 追加分類	○ ¹⁶⁾	×
SCLM	サブクラス, 主分類	○ ¹⁷⁾	×
SCLS	サブクラス, 副分類	○ ¹⁸⁾	×
TECH	Technology Focus	○	○
TI	標題	○ (デフォルト)	○
TT	タイトルターム	○	×
UADV	Use/Advantage	○	○
UP	更新日	○	○
UPA	ポリマーコードの更新日	○	○
UPAB	抄録の更新日	○	○
UPB	ケミカルコードの更新日	○	○
UPDA	ドキュメンテーション抄録の更新日	○	○
UPIN	発明者の更新日	○	○
UPIIT (UPKW)	索引の更新日	○	○

(続く)

- 1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには、HIT を使います (例 : => SEL HIT TI)
- 2) 出願番号, 優先権番号, および特許番号は、SET PATENT コマンドで設定されている形式 (ダウエント形式または STN 形式) で SELECT, ANALYZE および SORT されます。
- 11) 特許発行国と指定国が抽出され、SELECT で抽出されたタームに /PCS が付与されます。
- 12) 特許番号が抽出され、SELECT で抽出されたタームに /PN が付与されます。
- 13) Basic 特許の特許番号が抽出され、SELECT で抽出されたタームに /PN.B が付与されます。
- 14) 優先権出願番号が抽出され、SELECT で抽出されたタームに /PRN が付与されます。
- 15) SELECT で抽出されたタームに /IC が付与されます。
- 16) SELECT で抽出されたタームに /ICA が付与されます。
- 17) SELECT で抽出されたタームに /ICM が付与されます。
- 18) SELECT で抽出されたタームに /ICS が付与されます。

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
UPP	特許ファミリーの更新日	○	○
UPPA	特許出願人の更新日	○	○
UPPI	特許情報の更新日	○	○
UPPR	優先権情報の更新日	○	○
UPTI	標題の更新日	○	○
USE	Use	○	○

1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには、HIT を使います (例 : => SEL HIT TI)

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (公報レベルのみ)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
ABDE	抄録, オリジナル (ドイツ語)	○ ²⁾	×
ABEN	抄録, オリジナル (英語)	○ ²⁾	×
ABES	抄録, オリジナル (スペイン語)	○ ²⁾	×
ABFR	抄録, オリジナル (フランス語)	○ ²⁾	×
ABOL	抄録, オリジナル (その他の言語)	○ ²⁾	×
AG	代理人	○	○
AG. T	代理人 (全フィールド)	○	○
AGA	代理人住所	○	○
AGA. CNY	代理人住所, 国	○	○
AGA. CTY	代理人住所, 市	○	○
AN. PUB	レコード番号, 公報レベル	○	×
APTS	出願情報 (Clarivate Analytics)	○	×
CLM (MCLM)	クレーム	○ ²⁾	×
CLMDE	クレーム (ドイツ語)	○ ²⁾	×
CLMEN	クレーム (英語)	○ ²⁾	×
CLMFR	クレーム (フランス語)	○ ²⁾	×
FA. M	フィールドの存在 (公報レベル)	○	×
FS. M	ファイルセグメント (公報レベル)	○	○
IIC	国際特許分類, 発行時	○	×
IICA	国際特許分類, 発行時, 追加分類, (参考情報記号)	○	×
IICI	国際特許分類, 発行時 インデキシングコード (相補記号情報)	○	×
IICM	国際特許分類, 発行時, 主分類	○	○
IICS	国際特許分類, 発行時, 副分類	○	×
IN. NAT	発明者, 国籍	○	○
IN. T	発明者 (全フィールド)	○	○
INA	発明者住所	○	○
INA. CNY	発明者住所, 国	○	○
INA. CTY	発明者住所, 市	○	○
INCL	米国特許分類, 発行時	○	○
INCLM	米国特許分類, 発行時, 主分類	○	×
INCLS	米国特許分類, 発行時, 副分類	○	×
INO	発明者, オリジナル	○	○
ISCG	国際特許分類, 発行時 サブクラスグループ	○ ³⁾	×
ISCGA	国際特許分類, 発行時, サブクラスグループ, 追加分類	○ ⁴⁾	×

(続く)

1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには、HIT を使います (例 : => SEL HIT TI).

2) SELECT で抽出されたタームに /BIEX が付与されます.

3) SELECT で抽出されたタームに /IIC が付与されます.

4) SELECT で抽出されたタームに /IICA が付与されます.

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (公報レベルのみ) (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
ISCGS	国際特許分類, 発行時 サブクラスグループ, 副分類	○ ⁵⁾	×
ISCL	国際特許分類, 発行時, サブクラス	○ ³⁾	×
ISCLA	国際特許分類, 発行時, サブクラス, 追加分類	○ ⁴⁾	×
ISCLM	国際特許分類, 発行時, サブクラス, 主分類	○ ⁶⁾	×
PA. NAT	特許出願人, 国籍	○	○
PA. LIM	特許出願人, 国	○	○
PA. RES	特許出願人, 所在地	○	○
PA. T	特許出願人 (全フィールド)	○	○
PAA	特許出願人住所	○	○
PAA. CNY	特許出願人住所, 国	○	○
PAA. CTY	特許出願人住所, 市	○	○
PAO	特許出願人住所, オリジナル	○	○
PRTS	優先権情報 (Clarivate Analytics)	○ ^{7), 8)}	×
TIDE	原標題 (ドイツ語)	○	○
TIEN	原標題 (英語)	○	○
TIES	原標題 (スペイン語)	○	○
TIFR	原標題 (フランス語)	○	○

1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには, HIT を使います (例 : => SEL HIT TI).

3) SELECT で抽出されたタームに /IIC が付与されます.

4) SELECT で抽出されたタームに /IICA が付与されます.

5) SELECT で抽出されたタームに /IICS が付与されます.

6) SELECT で抽出されたタームに /IICM が付与されます.

7) 出願番号, 優先権番号, および特許番号は, SET PATENT コマンドで設定されている形式 (ダウエント形式または STN 形式) で SELECT, ANALYZE および SORT されます.

8) (公報レベルの) 出願番号と優先権出願番号が抽出され, SELECT で抽出されたタームに /PRTS が付与されます.

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (DCR セグメント)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
AN. S	DCR レコード番号, DCR セグメント	○	×
CC	分類コード (物質ディスクプタ)	○	×
CMT	注記	○	×
CN (SY)	化学物質名	○ ²⁾	×
CN. P	優先化学物質名	○	×
CN. S	統制化学物質名	○	×
CT	DDF 統制語	○	×
DCSE	DCR 番号, DCR セグメント	○	○
DDRN	ダウエントドラッグ登録名	○	○
EDCR	DCR 入力日	○	○
MW	分子量	○	○
SCR	構造クロスリファレンス	○	×
SDCN	ダウエント化合物番号, DCR セグメント	○	○
SDRN	ダウエント登録番号, DCR セグメント	○	○
SRIN	リングインデックス番号, DCR セグメント	○	×
SS	部分構造用語	○	×
SY (CN)	同義名	○	×
UPCR	DCR 更新日	○	○
UPWX	WPI クロスリファレンス更新日	○	○

1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには, HIT を使います (例 : => SEL HIT TI).

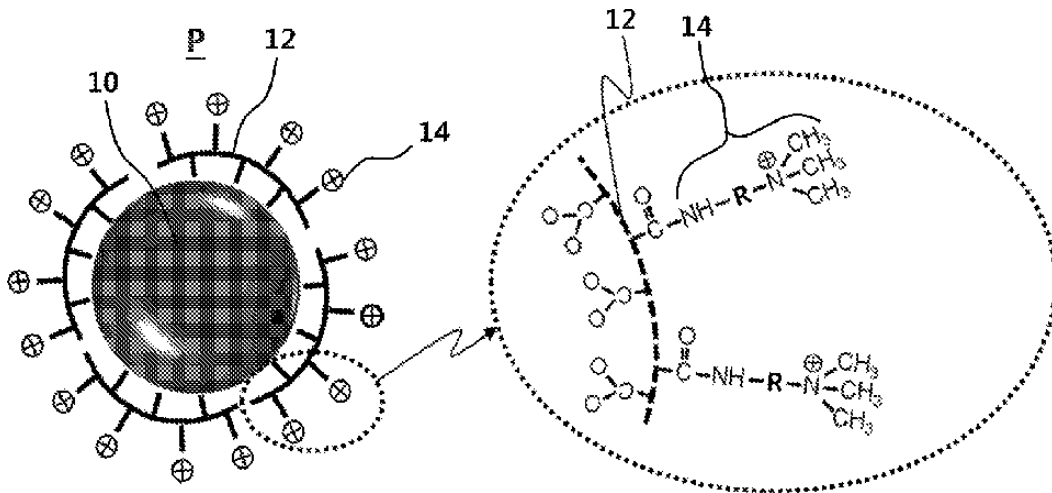
2) CN. P および SY が抽出され, SELECT で抽出されたタームに /CN が付与されます.

サンプルレコード

MAXG 形式での表示 (STN 形式)

レコード番号 AN 2012-C38268 [201216] WPIX Full-text
 入力日 ED 20120306
 標題 TI Positively-charged superparamagnetic iron oxide nanoparticle, used in contrast agent (MRI and/or optical imaging), comprises superparamagnetic iron oxide nanoparticle, polymer layer with carboxyl group and cationic material with amine group
 ダウエントクラス DC A89; B04; P42; S03
 発明者名 IN CHOI Y; KIM D; KIM H; KIM I; KIM Y; CHOI Y D; KIM D H; KIM H J; KIM I H; KIM Y H
 特許出願人 PA (NACA-N) NAT CANCER CENT
 特許発行国数 CYC 3
 特許情報 PI US 20120045399 A1 20120223 (201216)* EN 18[11]
 JP 2012044130 A 20120301 (201216) JA 21
 KR 2012017556 A 20120229 (201218) KO
 KR 1244140 B1 20130314 (201329) KO
 出願情報の詳細 ADT US 20120045399 A1 US 2011-13013193 20110125; KR 2012017556 A KR 2010-80216 20100819; JP 2012044130 A JP 2010-232806 20101015; KR 1244140 B1 KR 2010-80216 20100819
 出願経過の詳細 FDT KR 1244140 B1 Previous Publ KR 2012017556 A
 優先権出願情報 PRAI KR 2010-80216 20100819
 国際特許分類 IPCI A61B0005-055 [I, A]; A61K0049-00 [I, A]; A61K0049-06 [I, A]; A61K0049-18 [I, A]; B05D0005-12 [I, A]; B82B0003-00 [I, A]; B82Y0015-00 [N, A]; B82Y0005-00 [N, A]; C01G0049-00 [I, A]; C01G0049-02 [I, A]; C01G0049-06 [I, A]; C01G0049-08 [I, A]; C09K0011-00 [I, A]; C12Q0001-02 [I, A]; H01F0001-34 [I, A]; A61K0049-06 [I, A]; B82B0003-00 [I, A]; C01G0049-02 [I, A]
 共通特許分類 CPC A61K0049-1833; A61K0049-1854; B82Y0015-00; B82Y0005-00
 ヨーロッパ特許分類 EPC B82Y0015-00
 米国特許分類 NCL NCLM 424/009.323
 NCLS 424/009.600
 FI FGL Main: H01F0001-34 Z
 Secondary: A61B0005-05 383; C01G0049-00 A; C01G0049-00 H; C01G0049-06 B; C01G0049-08 A
 F ターム FTRM 4C096; 4G002; 5E041; 4G002/AA03; 4G002/AA04; 4G002/AA06; 4C096/AA11; 4G002/AB02; 4C096/AB07; 5E041/AB16; 5E041/AB19; 4G002/AD04; 4G002/AE02; 5E041/BC05; 5E041/BD07; 5E041/CA10; 4C096/FC14; 5E041/NN05; 5E041/NN06

図面



MAXG 形式での表示 (STN 形式) (続き)

図面関連情報	GINF Type	Format	embedded Size
		Draw. Image	GI.DRW false 12203
抄録	AB	US 20120045399 A1	UPAB: 20120306
		NOVELTY - Positively-charged superparamagnetic iron oxide nanoparticle (SPION) comprises: a SPION (10); a polymer layer (12) including a polymer containing many carboxyl groups coated on a surface of the SPION; and a cationic material (14) coupled via an amide bond to a surface of the polymer layer.	
		DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for:	
		(1) a contrast agent comprising the positively-charged SPION; and	
		(2) preparing the positively-charged SPION comprising: (a) preparing a SPION whose	
		:	
		USE - The positively-charged SPION is useful in a contrast agent which is used for MRI and/or optical imaging (claimed).	
		ADVANTAGE - The positively-charged SPION: can be prepared in a simple and reproducible process to have hydrophilicity and a strong positive charge which have high uptake into a cell and stability; maintains very stable dispersibility in an aqueous solution	
		:	
		DESCRIPTION OF DRAWINGS - The figure shows a schematic view of a structure of a positively-charged SPION.	
		SPION (10)	
		Polymer layer (12)	
		Cationic material (14)	
Technology Focus	TECH	INORGANIC CHEMISTRY - Preferred Components: The positive charge has a surface zeta potential of at least +30 mV. The positively-charged SPION has an average diameter of 10-500 nm. The cationic material is quaternary ammonium containing an amine group. The SPION includes maghemite (gamma-Fe2O3) or magnetite. The SPION further comprises at least one of	
		:	
拡張抄録	ABEX	EXAMPLE - Oleic acid-coated superparamagnetic iron oxide (magnetite) nanoparticles (OA-SPIONs) (200 mg) were added to toluene (2 ml) and stirred for 1 day at 25 degrees C to be well dispersed. Diethylene glycol	
		:	
索引	IT	UPIT 20120306	
		104380-CL 104380-USE; 10151-CL 10151-USE; 105439-CL 105439-USE; 1572-CL 1572-USE; 130522-CL 130522-USE; 131071-CL 131071-USE; 131924-CL 131924-USE; 133966-CL 133966-USE; 200332-CL 200332-USE; 152620-CL 152620-USE; 355944-CL 355944-USE	
ファイルセグメント マニュアルコード	FS	CPI; GMPI; EPI	
	MC	CPI: A10-E17; A11-B05; A12-E13; A12-V03C2; B04-C03; B05-A03A; B05-A03B; B05-B01A; B06-A02; B06-A03; B11-C12; B12-K04C; B12-M11Q	
		EPI: S03-E04X; S03-E07A	
新ポリマー索引	PLE	UPA 20120306	
		[1.1] 2004 G0760 G0022 D01 D12 D10 D51 D53 D58 D60 D85 F37 F35 E00 E03 DCN: R00654 DCR: 7490; H0000; S9999 S1627 S1605; M9999 M2028; L9999 L2391; L9999 L2028;	
		[1.2] 2004 G0760 G0022 D01 D12 D10 D51 D53 D58 D60 D85 F37 F35 E00 E03 DCN: R00654 DCR: 7490; H0000; M9999 M2391; S9999 S1627 S1605; M9999 M2028; L9999 L2391; L9999 L2028;	
		:	
ケミカルコード	CMC	UPB 20120306	
		DRN: 0460-U 1508-U 1508-U	
		DCR: 10151-U 105439-U 1572-U	
		M1 *01* H7 H714 H721 J0 J011 J1 J171 M210 M212 M262 M281 M320 M423 M430 M510 M520 M530 M540 M630 M782 P831 R032 M905 M904 DCN: RA02LO-K RA02LO-M RA037T-K RA037T-M DCR: 104380-K 104380-M	
		M2 *01* H7 H721 J0 J011 J1 J171 M210 M213 M232 M262 M281 M320 M416 M430 M782 P831 R032 M905 M904 M910 DCN: R00460-K R00460-M DCR: 10151-K 10151-M	
		:	

MEMB 形式での表示 (ダウエント形式)

Member (0001)

特許情報 PI JP--2013014076 A 20130124 (201319)* JA 11[4]
 英語標題 TIEN APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING IMAGE AND PROGRAM
 発明者名 IN KAWAKATSU S
 INO: KAWAKATSU SHIGEYUKI
 INA: JP

特許出願人 PA (MURK-C) MURATA KIKAI KK
 PAO: MURATA MACHINERY LTD
 PAA: JP

出願情報の詳細 ADT JP--2013014076 A 2011JP-000148473 20110704
 出願情報 (Clarivate APTS 2011JP-000148473 20110704
 Analytics) IPCI Current: B41J0029-38 [I, A]; G06F0001-32 [I, A]; H04N0001-00 [I, A]
 発行時の国際特許分類 Original: B41J0029-38 [I, A]; G06F0001-32 [I, A]; H04N0001-00 [I, A]
 FI FCL Main: B41J0029-38 D
 Secondary: G06F0001-00 332 B; H04N0001-00 C

F ターム FTRM 2C061; 5B011; 5C062; 5C062/AA05; 5C062/AA14; 5C062/AA35; 5C062/AB49;
 5C062/AC58; 5C062/AE15; 2C061/AP07; 5B011/EB08; 2C061/HH11; 2C061/HT02;
 2C061/HT13; 5B011/LL11

英語抄録 ABEN Control electric power mode at a suitable timing, and provide the image processing apparatus which can make the convenience and power saving property to a user make compatible. The mode switch part which switches the sub control part which detects transfer instruction|command from the timepiece circuit unit, the 1st power saving mode which stops supply of the power supply to the main control part, and the 2nd power saving mode which stops supply of the electric power to the main control part and a network-control part is provided. The main control part transmits transfer information to a sub control part, when transferring to 1st power saving mode. The timepiece circuit unit transmits transfer instruction|command to a sub control part, when it determines with the present|current time having turned into time designated with time information based on the comparison. A sub control part responds to transfer information, when transfer instruction|command is detected between 1st power saving modes, and it is transfer to normal mode from 1st power saving mode. The transfer to 2nd power saving mode from 1st power saving mode is made to be switched to a mode switch part. FIG. 3 This invention relates to the image processing apparatus, the image-processing method, and program which have power saving mode. If the time which was :

英語クレーム CLMEN The network-control part connected to a network, The main control part which controls the said network-control part, The preset time information is memorize|stored, And time is measured, The timepiece circuit unit which outputs the transfer instruction|command which compares the memorize|stored said time information with the measured time, and becomes the said comparison with the trigger of transfer of electric power mode based on a result, The sub control part which memorize|stores the transfer information which shows the electric power mode which should transfer, and detects the said transfer instruction|command from the said timepiece circuit unit, 1st power saving mode which stops supply of the power supply to the said main control part, The mode switch part which switches the 2nd power saving mode which stops supply of the electric power to the said main control part and the said network-control part is provided, The said main control part transmits the said transfer information to the said sub control part, when transferring to said 1st power saving mode, The said timepiece circuit unit transmits the said transfer instruction|command to the said sub control part, when it determines with the present|current time having turned into time designated with the said time information based on the said comparison, When the said sub control part detects the said transfer instruction|command between said 1st power saving modes, It responds to the said transfer information and is transfer to normal mode from said 1st power saving mode, It selectively controls by making the transfer to said 2nd power saving mode from said 1st power saving mode switched to the said mode switch part. Image processing apparatus.

MEMB 形式での表示 (ダウエント形式) (続き)

Member (0002)

特許情報 PI US-20130124893 A1 20130516 (201333) EN
 英語標題 TIEN IMAGE PROCESSING APPARATUS AND IMAGE PROCESSING METHOD
 発明者名 IN KAWAKATSU S
 INO: KAWAKATSU, Shuji
 INA: Kyoto-shi, JP

特許出願人 PA (MURK-C) MURATA MACHINERY LTD
 PAO: MURATA MACHINERY, LTD.
 PAA: Kyoto-shi, JP

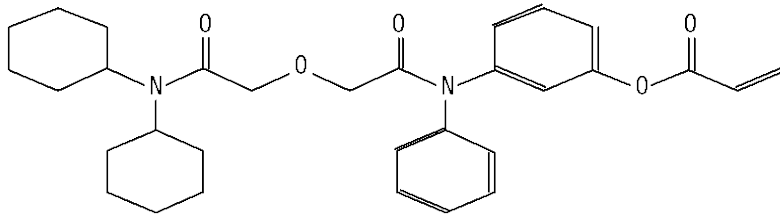
出願情報の詳細 ADT US-20130124893 A1 2012US-013469107 20120511
 出願情報 (Clarivate Analytics) APTS 2012US-000469107 20120511
 優先権出願情報 PRAI 2011JP-000148473 20110704
 優先権出願情報 (Clarivate Analytics) PRTS 2011JP-000148473 20110704
 IPCI Current: G06F0001-32 [I,A]
 Original: G06F0001-32 [I,A]
 発行時の国際特許分類 CPC Current: G06F0001-3203
 Original: G06F0001-3203

英語抄録 ABEN An image processing apparatus includes a network control unit, a main control unit, a clock circuit unit, a sub control unit, and a power mode switching unit. The main control unit transmits transition information to the sub control unit during a transition to a first power saving mode when power supply to the main control unit is stopped. The clock circuit unit transmits a transition instruction to the sub control unit at a specified time. When detecting the transition instruction during the first power saving mode, the sub control unit selectively controls the power mode switching unit to switch a power mode based on the transition information between transition from the first power saving mode to the normal mode and transition from the first power saving mode to the second power saving mode when power supply to the main control unit and the network control unit is stopped.

英語クレーム CLMEN What is claimed is: 1 . An image processing apparatus comprising: a network control unit connected to a network; a main control unit arranged to control the network control unit; a clock circuit unit arranged to store information on a specified time which has been previously set, to measure time, to compare time information stored in the clock circuit unit to time measured by the clock circuit unit, and to output a transition instruction, which is a trigger for power mode transition, according to a time comparison performed by the clock circuit unit; a sub control unit arranged to store transition information on a power mode to be transferred next and to detect the transition instruction input from the clock circuit unit; and a power mode switching unit arranged to switch the power mode from/to a first power saving mode in which power supply to the main control unit is stopped to/from a second power saving mode in which power supply to the main control unit and the network control unit is stopped; wherein the main control unit transmits the transition information to the sub control unit at a time of transition to the first power saving mode; the clock circuit unit transmits the transition instruction to the sub control unit upon determination, based on a time comparison, that the specified time in the information stored in the clock circuit unit has arrived; and the sub control unit selectively controls the power mode switching unit to switch the power mode based on the transition information between transition from the first power saving mode to a normal mode and transition from the first power saving mode to the second power saving mode upon detection of the transition instruction during the first power saving mode.

MAX 形式での表示 (DCR セグメント)

DCR レコード番号 AN.S DCR-1000003
 DCR 番号 DCSE 1000003-0-0-0
 化学物質名, 統制 CN.S Acrylic acid 3-([[(dicyclohexylcarbamoyl)-methoxy]-acetyl]-phenyl-amino)-phenyl ester



分子式 MF C31 H38 N2 O5
 標準化された分子式 SMF C31 H38 N2 O5 *1; TOTAL *1; TYPE *1
 分子量 MW 518.65
 ダウエント登録番号 SDCN RAG9YE
 分類コード GC UNSATURATED FATTY ACIDS

特許出願人コード (/PACO) シソーラスの EXPAND

=> E SHAF-C+DEF/PACO
 E1 101423 --> SHAF-C/PACO
 E2 DEF FUJITSU DISPLAY TECH CO LTD/PACO
 E3 DEF FUJITSU DISPLAY TECH LTD/PACO
 E4 DEF FUJITSU DISPLAY TECHNOLOGIES CORP/PACO
 E5 DEF FUJITSU DISPLAY TECHNOLOGIES KK/PACO
 E6 DEF FUJITSU DISPLAY TECHNOLOGY CO LTD/PACO
 E7 DEF SHARP 3D INC/PACO
 E8 DEF SHARP CORP/PACO
 E9 DEF SHARP CORP KK/PACO
 E10 DEF SHARP DO BRASIL IND EQUIP ELETRONICOS SA/PACO
 E11 DEF SHARP ELECTRONICA ESPAN SA/PACO
 E12 DEF SHARP ELECTRONICS CO LTD/PACO
 E13 DEF SHARP ELECTRONICS CORP/PACO
 E14 DEF SHARP INC/PACO
 E15 DEF SHARP KK/PACO
 E16 DEF SHARP KOREA ELETRONIC CO/PACO
 E17 DEF SHARP LAB AMERICA INC/PACO
 E18 DEF SHARP LAB EURO LTD/PACO
 E19 DEF SHARP LAB INC/PACO
 E20 DEF SHARP MFG CO AMERICA/PACO
 E21 DEF SHARP MFG CO UK/PACO
 E22 DEF SHARP MFG SYSTEM KK/PACO
 E23 DEF SHARP MICROELECTRONICS TECHNOLOGY INC/PACO
 E24 DEF SHARP NIIGATA CORP/PACO
 E25 DEF SHARP NIIGATA DENSHI KOGYO KK/PACO
 E26 DEF SHARP NIIGATA ELECTRONICS CORP/PACO
 E27 DEF SHARP TAIWAN ELECTRIC CO/PACO
 E28 DEF SHARP TAKAYA DENSHI KOGYO KK/PACO
 E29 DEF SHARP TAKAYA ELECTRONICS IND CO LTD/PACO
 E30 DEF SHARP TECHNO-SYSTEM KK/PACO
 ***** END *****